(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-269593

(43)公開日 平成9年(1997)10月14日

(51) Int.Cl.6		識別記号 .	庁内整理番号	FΙ					技術表示箇所
G03F	7/00	503		G 0	3 F	7/00		503	
	7/004	501				7/004		501	
	7/027	5 O 2				7/027		502	
	7/028					7/028			
	7/085					7/085			
	-		審査請求	未請求	請求其	質の数 2	OL	(全 49 頁)	最終頁に続く
(21) 出願番号		特顧平8-78868		(71)	人類出	000005	201		
						富士写	真フイ	ルム株式会社	
(22)出顧日		平成8年(1996)4月			神奈川	県南足	柄市中沼210種	静 地	
				(72)発明者		西宫	伸幸		
						静岡県	榛原郡	吉田町川尻40	00番地 富士写
						真フイ	ルム株	式会社内	
				(72)	発明者	東達	治		
						静岡県	榛原郡	吉田町川尻40	00番地 富士写
						真フイ	ルム株	式会社内	
				(72)	発明者	曾呂利	忠弘		
				1		静岡県	榛原郡	吉田町川尻40	00番地 富士写
						真フイ	ルム株	式会社内	
				(74)	代理人	弁理士	萩野	平 (外3	名)

(54) 【発明の名称】 感光性平版印刷版

(57)【要約】

(修正有)

【課題】 感光層と支持体が光接着して強固な感光層/ 支持体密着力を発現し、かつ非画像部が十分な親水性を 有する、感光性平版印刷版を提供する。

【解決手段】 分子量1000以下のフェノール類又は 有機リン酸系化合物を溶解した溶媒中で下記一般式

(I) 又は(II) で表される化合物を加水分解および重縮合させて得られる組成物を、基板表面に塗布・乾燥して得られた層の上に、感光層を設けた感光性平版印刷版。

A.M (R) a

(1)

 $A' \cdot M(R)$

(II)

(式中、Mはケイ素、アルミニウム等、を表わす。Aは水素、置換又は無置換のアルキル基等、又はラジカルによって付加反応を起こし得る官能基を表わす。A'は、ラジカルによって付加反応を起こし得る官能基を表す。Rは、特定の含酸素官能基を表す。mは0又は正の整数でm+n=3又は4を表わし、mが2以上の場合は、Aは同種のものとすることも、異種のものが交ったものとすることもできる。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 分子量1000以下のフェノール類又は 有機リン酸系化合物を溶解した溶媒中で下記一般式

(1)で表される化合物を加水分解および重縮合させて 得られる組成物を、基板表面に塗布・乾燥して得られた 層の上に、感光層を設けたことを特徴とする感光性平版 印刷版。

$$A_{\bullet}M(R)_{\bullet} \qquad (I)$$

(式中、Mは、ケイ素、アルミニウム、チタン又はジルコニウムを表わす。Aは、水素、アルキル基、アリール基、アルケニル基、プロパルギル基、アルコキシ基、エポキシアルキル基、シリル基、シロキシ基又はラジカルによって付加反応を起こし得る官能基を表わす。Rは、下記(a)~(e)のいずれかを表す。)

$$-O-N=C < \frac{B_s}{K_t}$$
 (P)

$$-O-R^{1}$$
 (c)

$$\begin{array}{c}
R^1 \\
-N-C-R^2 \\
0
\end{array}$$

$$-0-C \stackrel{R'}{\sim}_{CH_2}$$
 (e)

(R¹ 及びR² は、同じであっても異なっていてもよ

く、それぞれアルキル基、アルケニル基、アリール基を表わす。)、mは0又は正の整数でm+n=3又は4を表わし、mが2以上の場合は、Aは同種のものとすることも、異種のものが交ったものとすることもできる。) 【請求項2】 分子量1000以下のフェノール類又は 40有機リン酸系化合物を溶解した溶媒中でラジカルによって付加反応を起こし得る官能基を有する下記一般式(II)で表される化合物を加水分解および重縮合させて得られる組成物を、基板表面に塗布・乾燥して得られた層の上に、光重合性感光層を設けたことを特徴とする感光性平版印刷版。

$$A' \cdot M (R) \cdot (II)$$

(式中、Mは、ケイ素、アルミニウム、チタン又はジルコニウムを表わす。A'は、ラジカルによって付加反応を起こし得る官能基を表わす。Rは、下記(a)~

(e) のいずれかを表す。)

$$-O-N=C < \frac{R_5}{K_7}$$
 (P)

$$-O-R^{1}$$
 (c)

$$\begin{array}{c}
R^1 \\
-N-C-R^2 \\
0
\end{array}$$

$$20 - O - C \stackrel{R'}{\underset{CH_2}{\leftarrow}}$$
 (e)

(式中、 R^1 及び R^2 は、同じであっても異なっていてもよく、それぞれアルキル基、アルケニル基、アリール基を表わす。)、mは0又は正の整数でm+n=3又は4を表わし、mが2以上の場合は、A' は同種のものとすることも、異種のものが交ったものとすることもできる。)

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感光性印刷版に関し、特に、レーザ光で直接書き込み可能な感光性平版印刷版(以下、単に「PS版」という)に関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、ネガ型PS版は広く知られて おり、光に当ると硬化するジアゾ樹脂含有感光層を用い るもの、光重合性感光層を用いるもの、光架橋性感光層 を用いるものなどがある。ここで、光重合性及び光架橋 性という語句は、光によって発生させられた活性化学種 によって有機層の重合及び架橋が引き起される性質を意 味する。このようなPS版から印刷用の版を作るには、 これらの感光性層を有する PS版の上に透明ネガフィル ムの原稿をのせ、紫外光を用いて露光する操作が行なわ れる。その原稿が文字からなるものである場合も一部フ ィルムに原稿をとってからPS版に露光するという操作 が必要であるため、作業が煩雑となっていた。そこで、 感光層にある種の高感度な重合性層を用い、細くビーム を絞ったレーザ光をその版面上に走査させ、文字原稿、 画像原稿などを直接版面上に形成させ、フィルム原稿な しで直接製版する試みが鋭意なされてきた。例えば、特 公昭61-9621号、特開昭63-178105号、

特開平2-244050号公報等に記載の感光性組成物 の使用により、フィルム原稿なしで直接版を作ることが 可能である。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の こうした高感度光重合性の印刷版は、印刷版として使用 する時の条件にもよるが、感光層/支持体密着力が必ず しも強力ではないため、高速で大部数の印刷に使用する と、ベタ画像が抜けたり、細線がとんだりする不具合を 生ずる。感光層/支持体密着力を強力なものとするため 10 に支持体表面の粗面を粗くすると、確かに画像の耐久性 は向上するが、反面非画像部の親水性が低下し、印刷に 汚れを生じる結果となる。また、ジアゾ樹脂のような下 塗り層を用いて感光層/支持体間の密着力を向上させよ うとしても、ジアゾ基が光分解してそれ自身が支持体に 結合するプロセス及び/又はジアゾ基自身と感光層とが 結合するプロセスが進行しにくく、比較的多量の露光量 を必要とするため、レーザ露光で直接版を作ろうとする システムとは適合しない。そのためゾルゲル処理液によ り多くの重合性官能基を組み込んで界面での光接着をよ 20 り効率よく進行させることを試みられているが(例え ば、特開平7-159983号等)、重合性官能基を多 くしすぎると、非画像部の親水性が損なわれて汚れが生 じるという問題があった。従って、本発明は、高感度な 光重合性感光層が感光し、重合する間に該感光層と支持 体とが光接着して強固な感光層/支持体密着力を発現 し、且つ非画像部が十分な親水性を有する、特にレーザ 書き込み可能な光感光性PS版を提供することを目的と する。

【0004】また、従来のタイプのネガ型PS版、ポジ 型PS版においても非画像部の親水性の不足が実技上の 問題を起こすことが多く、特に感光層/支持体密着力を 高めようとして感光層中のバインダー成分を変更したり すると、印刷汚れを引き起こす場合がある。そこで、従 来タイプのネガ型PS版感光層またはポジ型PS版感光 層を有し、感光層/支持体密着力が十分で且つ非画像部 が十分な親水性を有する光感光性PS版を提供すること もまた本発明の目的である。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記目的 40 を達成するため鋭意検討した結果、

(1) 分子量1000以下のフェノール類又は有機リン 酸系化合物を溶解した溶媒中で下記一般式(I)で表さ れる化合物を加水分解および重縮合させ得られる組成物 を、基板表面に塗布・乾燥して得られた層の上に、感光 層を設けたことを特徴とする感光性平版印刷版。

$$A_{\bullet}M(R)_{n} \qquad (I)$$

(式中、Mは、ケイ素、アルミニウム、チタン又はジル コニウムを表わす。Aは、水素、置換又は無置換のアル キル基、置換又は無置換のアリール基、置換又は無置換 50 のアルケニル基、置換又は無置換のプロパルギル基、置 換又は無置換のアルコキシ基、置換又は無置換のエポキ シアルキル基、置換又は無置換のシリル基、置換又は無 置換のシロキシ基又はラジカルによって付加反応を起こ し得る官能基を表わす。 Rは、下記の一般式(a)~ (e) のいずれかを表す。)

[0006]

$$-O-N=C < \frac{R^{1}}{R^{2}}$$
 (b)

$$-O-R^{1} \qquad (c)$$

$$-0-C \stackrel{R^1}{\subset} H_{\bullet}$$
 (e)

【0007】(式中、R'及びR'は、同じであっても 異なっていてもよく、それぞれ置換又は無置換のアルキ ル基、置換又は無置換のアルケニル基、置換又は無置換 のアリール基を表わす。)、mは0又は正の整数でm+ n=3又は4を表わし、mが2以上の場合は、Aは同種 のものとすることも、異種のものが交ったものとするこ ともできる。)

(2)分子量1000以下のフェノール類又は有機リン 酸系化合物を溶解した溶媒中でラジカルによって付加反 応を起こし得る官能基を有する下記一般式(II)で表さ れる化合物を加水分解および重縮合させて得られる組成 物を、基板表面に塗布・乾燥して得られた層の上に、光 重合性感光層を設けたことを特徴とする感光性平版印刷 版。

$$A' \cdot M (R) \cdot (II)$$

(式中、Mはケイ素、アルミニウム、チタン又はジルコ ニウムを表わす。 A'は、ラジカルによって付加反応を 起こし得る官能基を表わす。Rは、下記の(a)~

(e) のいずれかを表す。

[0008]

【化4】

$$-O-N=C < \frac{R}{R},$$
 (P)

$$\begin{array}{c}
R^1 \\
-N-C-R^2 \\
0
\end{array}$$

$$-O-C \stackrel{R'}{\sim} CH_{\bullet}$$
 (e)

【0009】(R¹ 及びR² は、同じであっても異なっ ていてもよく、それぞれ置換又は無置換のアルキル基、 置換又は無置換のアルケニル基、置換又は無置換のアリ -ル基を表わす。)、mは0又は正の整数でm+n=3又は4を表わし、mが2以上の場合は、Aは同種のもの とすることも、異種のものが交ったものとすることもで きる。) によって、上記目的が達成できることを見い出 し、本発明に到ったものである。即ち、分子量1000 以下のフェノール類及び/又は有機リン酸系化合物がア ルカリ現像時に支持体非画像部から脱落し、その脱落し た部分の親水性を高める一方、支持体上に共有結合によ り植えつけられた有機官能基が感光層と有機一有機相互 作用することによってよく密着し、或いは、支持体上に 共有結合により植えつけられた付加反応性の官能基が光 重合性感光層と光接着して強固な感光層/支持体密着力 を発現し、且つ非画像部上では該付加反応性官能基が支 持体の親水性を低下させるには至らないほどの密度で存 在するため、非画像部には十分な親水性が保たれる。こ れにより、従来、密着性と親水性のコントロールが難し

かったゾルゲル処理液に重合性官能基をより多く組み込むことが可能となり光接着を効率よく進行させることができると共に、非画像部の親水性が損なわれず汚れを防止することができる。特に、上記(2)の発明により、レーザー書き込み可能な感光性 P S 版を好適に提供することができる。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳述する。一般式(I)及び(II)において、金属Mは、Si、A10 I、Ti、Zrの何れでもよく、Al、Si、Tiが原料入手性の点で好ましい。

【0011】一般式(I)及び(II)において、A及び A' は処理済表面に共有結合的に固定される官能基であ り、式(I)及び(II)の形で安定に存在するものであ ればいかなるものでもよい。処理済表面の化学反応性は A及びA'の種類と量によって制御することができる。 Aの代表例としては、水素、置換又は無置換のアルキル 基、置換又は無置換のアリール基、置換又は無置換のア ルケニル基、置換又は無置換のプロパルギル基、置換又 は無置換のアルコキシ基、置換又は無置換のエポキシア ルキル基、置換又は無置換のシリル基、置換又は無置換 のシロキシ基、又はラジカル反応によって付加反応を起 こしえる官能基が挙げられ、これらのものは、目的に応 じて例えば以下に示す様な1個もしくは複数の官能基に より、置換されていてもよい。ハロゲン基、アルキル 基、アリール基、ヒドロキシル基、アルコキシ基、アリ ールオキシ基、アシルオキシ基、カルバモイルオキシ 基、アルコキシカルボニルオキシ基、アシル基、アルコ キシカルボニル基、カルバモイル基、カルボキシ基、プ ロパルギル基、アミノ基、アルキルアミノ基、アシルア ミノ基、ウレイド基、カルバメート基、ジアゾニオ基、 ジアゾ基、アゾ基、メルカプト基、アルキルチオ基、ス ルホニル基、スルホ基、シアノ基、イソシアナト基、チ オイソシアナト基、スルファモイル基、ニトロ基、シリ ル基、シロキシ基。以下にAのより具体的な例を示す。

[0012]

【化5】

7 H-, HO-, CH₃-, C₂H₅-, (n)C₃H₅-, (i)C₃H₅-, (n)C₈H₁₇-, (n)C₁₂H₂₅-, (n)C₁₈H₃₇-, CH₂Cl-,

 $CF_2 \rightarrow CF_2 \rightarrow 3$, $HOCH_2CH_2CH_2 -$, $\bigcirc CH_2 -$,

 $CH_2 = CHCOO - (CH_2)_3$, $CH_2 = C(CH_3)COO - (CH_2)_3$,

 $CH_2 = CH - C = CH_2$, O

 ${\rm CH_{3}O^{-}},\ {\rm C_{2}H_{5}O^{-}},\ {\rm (n)C_{3}H_{7}O^{-}},\ {\rm (i)C_{3}H_{7}O^{-}},$

 ${\rm (n)C_4H_9O-,\ (t)C_4H_9O-,\ } \bigodot {\rm)-\ ,}$

【0013】A'はラジカルによって付加反応を起こしえる官能基を表し、上記Aで表される置換基のうち、ラジカルによって付加反応を起こしえる官能基であればいずれでもよい。以下に好適に使用されるA'の具体的な

例を示す。

[0014]

【化6】

9
CH₂=CHCOO-(CH₂)₃-, CH₂=C(CH₃)COO-(CH₂)₃-, CH₂=CH-C(=CH₂)-,
CH₂=CH-SO₂NH-(CH₂)₃-,

$$-conh + ch2 + \frac{1}{3}$$

CH3=CH- \ HC=C- \ CH3C=C- \

$$CH_3$$
 $N \leftarrow CH_2 \frac{10}{10} CONH \leftarrow CH_2 \frac{1}{3}$
 CH_3

【0015】一般式(I)及び(II)におけるRを表す式(a)~(e)中の R^1 、 R^2 は、置換又は無置換のアルキル基(好ましくは炭素数1~20、さらに好ましくは炭素数1~10、例えば、メチル、エチル、プロピル、ブチル)、置換又は無置換のアルケニル基(好ましくは炭素数2~20、さらに好ましくは炭素数2~10、例えば、ビニル、アリル)、置換又は無置換のアリール基(好ましくは炭素数6~20、さらに好ましくは炭素数6~10、例えば、ベンジル、ナフチル)である。また、-Rは一座配位型のものに限定されず、ジオール、トリオールなどの多座アルコキシド、シュウ酸、コハク酸などの多座有機酸残基とすることもできる。一

般式(I)及び(II)の化合物において、式(a)~40 (b)のR¹及びR²の一部もしくは全部がハロゲン原子に置きかわったものも、本発明に従う組成物を調製するための化合物として好適に使用することができる。更に詳しく述べれば、水、アルコール類などの作用によって、一般式(I)及び(II)で示される化合物を生成し得る、前駆体化合物も全て使用できる。ハロゲン原子の代表例はF、C1、Br及びIである。また、一般式(I)及び(II)において、式(a)~(b)のR¹及びR²の一部もしくは全部が加水分解及び重縮合反応を起して、分子中に金属一酸素一金属結合を有するに至った化合物も、本発明において使用することができる。

11

【0016】一般式(I)及び(II)で表わされる化合 物の具体例としては以下のようなものがある。

 $[0017]CH_2 = CH - Si(OCOCH_3)_3$, C $H_2 = C H - S i (O C_2 H_5)_3 , C H_2 = C H S i (O$ CH_3) 3 $CH_2 = CHCH_2Si(OC_2H_5)$ 3 C $H_2 = C H C H_2 N H (C H_2)_3 S i (O C H_3)_3 C$ $H_2 = C H C O O - (C H_2)_3 - S i (O C H_3)_3 , C$ $H_2 = C H C O O - (C H_2)_3 - S i (O C_2 H_5)_3$ $CH_2 = C (CH_3) COO - (CH_2)_3 - S i (OCH_3)_3 - S i$ $_{3})_{3}$, $CH_{2} = C (CH_{3}) COO - (CH_{2})_{3} - Si$ $(OC_2H_5)_3$, $CH_2=C$ (CH_3) COO- (C H_2) ₄ - S i (O C H_3) ₃ , C H_2 = C (C H_3) C O $O - (CH_2)_5 - Si(OCH_3)_3 \setminus CH_2 = CHCO$ $O-(CH_2)_4-Si(OCH_3)_3$, $Si(OCH_3)$ 4 、 Si (OC₂ H₅) 4 、 Si (OiC₃ H₇) 4 、 Si (OCOCH₃) 4 、 CH₃ S i (OCH₃) 3 、 C₂ H₅ Si (OCH₃)₃, C₆H₅Si (OCH₃)₃, Al $(OiC_3H_7)_3$, $Ti(OC_2H_5)_4$,

[0018] 【化7】

 $CH_2 = C(CH_3)COO - (CH_2)_3$ Si(OCH₃)₂ $CH_2 = C(CH_3)COO - (CH_2)_3$

> $CH_2 = CH$ $CH_2 = \dot{C} - Si(OCH_3)_3$

 $CH_2 = CH - SO_2NH - (CH_2)_3 - Si(OCH_3)_3$

$$O-Si(OCH_3)_2$$
 . $CONH-(CH_2)_3-Si(OCH_3)_3$.

 $[0019]CH_2 = CH - SO_2NH - (CH_2)_3 - S$ i (OCH₃)₃, $[0020]HC \equiv C - Si (OC_2H_5)_3, CH_3C \equiv$ $C-Si(OC_2H_5)_3$ [0021] 【化8】

 $HC \equiv C - Si(OC_2H_5)_3$, $CH_3C \equiv C - Si(OC_2H_5)_3$

*20

 $[0022]CH_2 = CHCH_2O - Si(OCH_3)_3$ $(C H_2 = C H C H_2 O) \cdot S i \cdot H O - C H_2 - C \equiv C S i (O C_2 H_5)_3$, $C H_3 C H_2 C O - C \equiv C - S i$ $(O C_2 H_5)_3$, $C H_2 = C H S - (C H_2)_3 - S i$ $(O 30)_3$ $C H_3$) 3, $C H_2 = C H C H_2 O - (C H_2)_2 - S C H_2$ $-Si(OCH_3)_3, CH_2 = CHCH_2S - (CH_2)_3$ $-S-S i (OCH_3)_3, (CH_3)_3 CCO-C \equiv C S i (O C_2 H_5)_3, (C H_2 = C H)_2 N - (C H_2)_2$ -SCH₂-Si(OCH₃)₃

[0023] 【化9】

$$CH_2NH-(CH_2)_3$$
 Si(OCH₃)₃ .

 $[0024] CH_3 COCH = C (CH_3) - O - S i$ (OCH₃)₃

【0025】次に、本発明の分子量1000以下のフェ ノール類及び有機リン酸系化合物について説明する。本 発明で使用する分子量1000以下のフェノール化合物 は、例えば、特開平4-122938号、特開平2-2 8531号、米国特許第4916210号、欧州特許第 219294号等に記載の方法を参考にして、当業者に 於て容易に合成することが出来る。本発明にフェノール 化合物の具体例を以下に示すが、本発明で使用できる化 合物はこれらに限定されるものではない。

【0026】フェノール、p-クレゾール、m-クレゾ ール、α-クレゾール、2,3-ジメチルフェノール、 2, 4-ジメチルフェノール、2, 5-ジメチルフェノ ール、2,6-ジメチルフェノール、3,4-ジメチル フェノール、3,5ージメチルフェノール、2,3,4 ートリメチルフェノール、2,3,5ートリメチルフェ ノール、3,4,5-トリメチルフェノール、2,4, 5-トリメチルフェノール、メチレンビスフェノール、 メチレンビス p ークレゾール、レゾルシン、カテコー ル、2-メチルレゾルシン、4-メチルレゾルシン、o ークロロフェノール、mークロロフェノール、pークロ ロフェノール、2, 3 ージクロロフェノール、p ーメト キシフェノール、mーメトキシフェノール、pープトキ 40 シフェノール、o-エチルフェノール、m-エチルフェ ノール、p-エチルフェノール、2,3-ジエチルフェ ノール、2,5-ジエチルフェノール、p-イソプロピ ルフェノール、p ーターシャリーブチルフェノール、ピ ロガロール、 α ーナフトール、 β ーナフトール、2, 3 ージヒドロキシナフタレン、4-フェニルフェノール、 【0027】フロログルシン、2,3,4ートリヒドロ キシベンゾフェノン、2,3,4,4'ーテトラヒドロ キシベンゾフェノン、2,3,4,3',4',5'-ヘキサヒドロキシベンゾフェノン、フロログルコシド、

2, 4, 2', 4'ービフェニルテトロール、4, 4'

ーチオビス(1,3ージヒドロキシ)ベンゼン、2, 2', 4, 4'ーテトラヒドロキシジフェニルエーテ ル、2,2',4,4'ーテトラヒドロキシジフェニル スルフォキシド、2, 2', 4, 4'ーテトラヒドロキ シジフェニルスルフォン、トリス(4-ヒドロキシフェ ニル) メタン、1、1ービス(4ーヒドロキシフェニ ル) シクロヘキサン、4, 4-(α-メチルベンジリデ ン) ビスフェノール、 α , α' , α'' ートリス (4ーヒ ドロキシフェニル) -1, 3, 5-トリイソプロピルベ ンゼン、 α , α' , α'' ートリス (4-ヒドロキシフェ 10ニル) -1-エチル-4-イソプロピルベンゼン、1, 2, 2-トリス(ヒドロキシフェニル)プロパン、1, 1, 2-トリス(3, 5-ジメチルー4ーヒドロキシフ ェニル)プロパン、2,2,5,5-テトラキス(4-ヒドロキシフェニル) ヘキサン、1,2-テトラキス (4-ヒドロキシフェニル) エタン、1, 1, 3-トリ ス (ヒドロキシフェニル) ブタン、パラ (α, α, α) α' , α' - \mathcal{F} トラキス (4- \mathcal{F} ロキシフェニル) -キシレン、

13

【0028】2, 4, 4'ートリヒドロキシベンゾフェ 20 ノン、2,4,6-トリヒドロキシベンゾフェノン、 2, 3, 4-トリヒドロキシー2'ーメチルベンゾフェ **ノン、2, 2′, 4, 4′ーテトラヒドロキシベンゾフ** ェノン、2, 4, 6, 3', 4'ーペンタヒドロキシベ ンゾフェノン、2,3,4,2',4'ーペンタヒドロ キシベンゾフェノン、2,3,4,2',5'ーペンタ ヒドロキシベンゾフェノン、2,4,6,3',4', 5'-ヘキサヒドロキシベンゾフェノン、2,3,4-トリヒドロキシアセトフェノン、2、3、4ートリヒド ロキシフェニルペンチルケトン、2、3、4-トリヒド 30 ロキシフェニルヘキシルケトン、ビス(2,4-ジヒド ロキシフェニル) メタン、ビス(2,3,4-トリヒド ロキシフェニル) メタン、ビス(2,4-ジヒドロキシ フェニル) プロパン-1、ビス(2,3,4-トリヒド ロキシフェニル) プロパン-1、3,4,5-トリヒド ロキシ安息香酸プロピル、2,3,4-トリヒドロキシ 安息香酸フェニル、3.4.5-トリヒドロキシ安息香 酸フェニル、ビス(2,3,4-トリヒドロキシベンゾ イル) メタン、ビス(3-アセチル-4,5,6-トリ ヒドロキシフェニル) メタン、ビス(2,3,4-トリ 40 ヒドロキシベンゾイル)ベンゼン、ビス(2,4,6-トリヒドロキシベンゾイル) ベンゼン、エチレングリコ ールージ(3.5ージヒドロキシベンゾエート)、エチ レングリコールージ(3,4,5-トリヒドロキシベン ゾエート)、

【0029】2、3、4ービフェニルトリオール、3、 4, 5-ビフェニルトリオール、3, 5, 3', 5'-ビフェニルテトロール、2,4,2',4'ービフェニ ルテトロール、2, 4, 6, 3', 5'ービフェニルペ ントール、2, 4, 6, 2', 4', 6'ービフェニル 50

ヘキソール、2, 3, 4, 2', 3', 4'ービフェニ ルヘキソール、4,4'ーチオビス(1,3ージヒドロ キシ)ベンゼン、2,2',4,4'-ジフェニルスル フォン、4, 4', 4"ートリヒドロキシー3, 5, 3′、5′ーテトラメチルトリフェニルメタン、4、 4', 3", 4"ーテトラヒドロキシー3, 5, 3', 5'ーテトラメチルトリフェニルメタン、4,4', 2", 3", 4"ーペンタヒドロキシー3, 5, 3', 5'ーテトラメチルトリフェニルメタン、2,3,4, 2', 3', 4'-ヘキサヒドロキシー5, 5'-ジア セチルトリフェニルメタン、2,3,4,2',3', 4' - 3'', 4'' - 3''セチルトリフェニルメタン、2, 4, 6, 2', 4', 6′ーヘキサヒドロキシー5.5′ージプロピオニルト リフェニルメタン、

14

[0030]3, 3, 3', 3'-rhj + h-1,1'-スピロビーインダン-5,6,5',6'ーテト ロール、3, 3, 3', 3'ーテトラメチルー1, 1' -スピロビーインダン-5, 6, 7, 5', 6', 7' ーヘキソオール、3,3,3',3'ーテトラメチルー 1, 1'-スピロビーインダン-4, 5, 6, 4', 5', 6'-ヘキソオール、3, 3, 3', 3'-テト ラメチルー1,1'ースピロビーインダンー4,5, 6,5',6',7'ーヘキソオール、3,3ービス (3, 4-ジヒドロキシフェニル) フタリド、3, 3-ビス(2,3,4-トリヒドロキシフェニル)フタリ ド、3′, 4′, 5′, 6′ーテトラヒドロキシスピロ (フタリドー3, 9'ーキサンテン)、

【0031】モリン、ケルセチン、ルチン等のフラボノ 色素類、 α , α' , α'' ートリス (3, 5 ージメチルー 4-ヒドロキシフェニル) 1, 3, 5-トリイソプロピ ルベンゼン、 α , α' , α'' ートリス (3, 5 ージエチ ルー4ーヒドロキシフェニル) 1, 3, 5ートリイソプ ロピルベンゼン、 α , α' , α'' ートリス(3, 5ージ n-プロピルー4ーヒドロキシフェニル) 1, 3, 5-トリイソプロピルベンゼン、 α , α' , α'' ートリス (3, 5-ジイソプロピルー4-ヒドロキシフェニル) 1. 3. $5 - \text{hJ} / \text{J} / \text{J$ α"ートリス(3,5ージnーブチルー4ーヒドロキシ フェニル) 1, 3, 5ートリイソプロピルベンゼン、 フェニル) 1, 3, 5-トリイソプロピルベンゼン、 α , α' , α'' -トリス (3-メトキシー4-ヒドロキシフェニル) 1, 3, 5-トリイソプロピルベンゼン、 α , α' , α'' - トリス (2, 4 - ジヒドロキシフェニ ル) 1. 3. 5ートリイソプロピルベンゼン、1. 3. 5ートリス(3,5ージメチルー4ーヒドロキシフェニ ル) ベンゼン、1,3,5-トリス(5-メチル-2-ヒドロキシフェニル) ベンゼン、2,4,6ートリス (3,5-ジメチルー4-ヒドロキシフェニルチオメチ

ル) メシチレン、 $1-[\alpha-メチル-\alpha-(4'-ヒド$ ロキシフェニル)エチル] -4-[lpha, lpha' -ビス (4"-ヒドロキシフェニル)エチル]ベンゼン、1- $[\alpha - \forall f \nu - \alpha - (4' - \forall f \nu + \nu)] x f$ $|\mathcal{V}| = 3 - [\alpha, \alpha'] - \forall \lambda (4'') - \forall \lambda$ ル) エチル] ベンゼン、1-[α-メチル-α-(3',5'-ジメチルー4'-ヒドロキシフェニル) エチル] $-4-[\alpha, \alpha'- \forall \lambda (3'', 5''- \forall \lambda)$ ルー4"ーヒドロキシフェニル)エチル]ベンゼン、1 - [α - メチル - α - (3' - メチル - 4' - ヒドロキ 10]シフェニル) エチル] $-4-[\alpha', \alpha'- \forall X(3'')$ ーメチルー4″ーヒドロキシフェニル)エチル]ベンゼ ン、 $1-[\alpha-メチル-\alpha-(3'-メトキシ-4'-$ ヒドロキシフェニル) エチル] $-4-[\alpha',\alpha'-$ ビ ス(3"ーメトキシー4"ーヒドロキシフェニル)エチ ル] ベンゼン、 $1-[\alpha-メチル-\alpha-(2',4'-$ ジヒドロキシフェニル) エチル] $-4-[\alpha', \alpha'-$ ビス (4"ーヒドロキシフェニル) エチル] ベンゼン、 $1-[\alpha-メチルー\alpha-(2', 4'-ジヒドロキシフ]$ ェニル) エチル] $-3-[\alpha'', \alpha'- \forall X(4''- \forall 20)]$ ドロキシフェニル)エチル]ベンゼン等の特開平4-2 53058号に記載のポリヒドロキシ化合物、

【0032】p-ビス(2, 3, 4-トリヒドロキシベ ンゾイル) ベンゼン、p-ビス(2, 4, 6-トリヒド ロキシベンゾイル) ベンゼン、m-ビス(2,3,4-トリヒドロキシベンゾイル) ベンゼン、mービス(2, 4, 6-トリヒドロキシベンゾイル) ベンゼン、p-ビ ス(2、5ージヒドロキシー3ーブロムベンゾイル)ベ ンゼン、pービス(2,3,4-トリヒドロキシー5-メチルベンゾイル) ベンゼン、p-ビス(2,3,4-30 トリヒドロキシー5ーメトキシベンゾイル) ベンゼン、 pービス(2,3,4ートリヒドロキシー5ーニトロベ ンゾイル) ベンゼン、pービス(2,3,4-トリヒド ロキシー5-シアノベンゾイル)ベンゼン、1,3,5 ートリス(2.5-ジヒドロキシベンゾイル)ベンゼ ン、1、3、5ートリス(2、3、4ートリヒドロキシ ベンゾイル) ベンゼン、1、2、3-トリス(2、3、 4-トリヒドロキシベンゾイル)ベンゼン、1.2.4 ートリス(2,3,4ートリヒドロキシベンゾイル)ベ リヒドロキシベンゾイル) ベンゼン、 α , α' -ビス (2, 3, 4-トリヒドロキシベンゾイル) -p-キシ レン、 α , α' , α' ートリス (2, 3, 4ートリヒド ロキシベンゾイル) メシチレン、

【0033】2,6-ビス-(2'-ヒドロキシー 3'.5'ージメチルーベンジル)ーpークレゾール、 2, 6-ビスー(2'-ヒドロキシー5'-メチルーベ ンジル) - p - クレゾール、2,6-ビス-(2'-ヒ ドロキシー3′, 5′-ジーt-ブチルベンジル)-p ークレゾール、2,6ービスー(2'ーヒドロキシー

16 5'-エチルーベンジル)-p-クレゾール、2,6-ビスー(2'-4'-ジヒドロキシーベンジル)-p-クレゾール、2、6-ビスー(2'-ヒドロキシー3t ーブチルー5′ーメチルーベンジル) - p - クレゾー ル、2,6-ビスー(2',3',4'-トリヒドロキ シー5'-アセチルーベンジル)-p-クレゾール、 2, 6-ビスー(2', 4', 6'-トリヒドロキシー ベンジル) -p-クレゾール、2,6-ビス-(2'. 3′, 4′ートリヒドロキシーベンジル)ーpークレゾ ール、2,6-ビス-(2',3',4'-トリヒドロ キシーベンジル) -3, 5-ジメチルーフェノール、 4, 6-ビスー(4'-ヒドロキシー3', 5'-ジメ チルーベンジル)ーピロガロール、4,6ービスー (4'-ヒドロキシ-3', 5'-ジメトキシーベンジ ル)ーピロガロール、2.6ービスー(4'ーヒドロキ シー3', 5'ージメチルーベンジル)ー1, 3, 4-トリヒドロキシーフェノール、4、6ービスー(2′、 4', 6'ートリヒドロキシーベンジル)ー2, 4ージ メチルーフェノール、4, 6 - ビスー(2', 3',

4′ートリヒドロキシーベンジル)-2.5-ジメチル

-フェノール等を挙げることができる。

【0034】次に、本発明で使用する有機リン酸系化合 物について述べる。本発明に用いられる有機リン酸系化 合物は、(1) R³ - (PO(OH)₂)₄で表わされる 置換または無置換の脂肪族化合物または芳香族化合物 (nk1skk2), (2) $R^3 - (PO(OH)(R)$ **)))。で表わされる置換または無置換の脂肪族化合物ま** たは芳香族化合物(nは1または2)、(nが1のと き、R³、R⁴ は置換、又は無置換のアルキル基(好ま しくは炭素数1~14のもの)、アルコキシ基(好まし くは炭素数1~14のもの)、アリーロキシ基(好まし くは炭素数6~10のもの)、アリール基(好ましくは 炭素数6~10のもの)、アシル基(好ましくは炭素数 1~14のもの)、アシロキシ基(好ましくは炭素数1 ~14のもの)であり、nが2のときR³ はアルキレン 基(好ましくは炭素数1~14のもの)またはアリーレ ン基(好ましくは炭素数6~10のもの)を表し、R⁴ は前記定義のとおりであり、置換基としてはアルキル基 (但し、アリール残基に対する置換基に限る)、アリー ンゼン、1,2,4,5ーテトラキス(2,3,4ート 40 ル基(但し、アルキル残基に対する置換基に限る)、ア ルコキシ基、アシル基、アシロキシ基、アリーロキシ 基、ビニル基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、シア ノ基、ニトロ基、ハロゲンから選ばれた少くとも1種が 挙げられる)からなる化合物群より選ばれた少くとも1 種の化合物である。

> 【0035】アリーロキシ基としては、フェノキシ基、 p-クロロフェノキシ基、p-メチルフェノキシ基、ピ リジニル基、アリール基としては、フェニル基、o-ト リル基、mートリル基、pートリル基、pークロロフェ ニル基、アシル基としては、ホルミル基、アセチル基、

17

プロピオニル基、ベンゾイル基、アシロキシ基として は、アセトキシ基、プロピオニルオキシ基、ピバロイル オキシ基などが挙げられる。(1)及び(2)の化合物 は、塩の形で用いてもよい。塩としては、カリウム、ナ トリウム、リチウム等のアルカリ金属塩の他に、カルシ ウム、コバルト、鉄、ニッケル、マンガン、マグネシウ ム、バリウム、銅などの塩が挙げられる。

【0036】以下に具体例を示す。式(1)の化合物の 例としては、フェニルホスホン酸、フェニルリン酸、ナ フチルホスホン酸、ナフチルリン酸、グリセロホスホン 10 酸、グリセロリン酸、p-ニトロフェニルホスホン酸、 p-ニトロフェニルリン酸、p-メトキシフェニルホス ホン酸、pーメトキシフェニルリン酸、pーヒドロキシ フェニルホスホン酸、p-ヒドロキシフェニルリン酸、 pートリルホスホン酸、pートリルリン酸、pーアセチ ルフェニルホスホン酸、pーアセチルフェニルリン酸、 pーシアノフェニルホスホン酸、pーシアノフェニルリ ン酸、m-クロルフェニルホスホン酸、m-クロルフェ ニルリン酸、メチルホスホン酸、エチルホスホン酸、2 -カルボキシエチルホスホン酸、フォスフォノアセティ 20 ックアシッド、2-フェニルエチルホスホン酸、2-ヒ ドロキシエチルホスホン酸、1-ヒドロキシエタンー 1, 1-ジホスホン酸、アミノヘキシルリン酸、2-メ トキシエチルホスホン酸、2-アセチルエチルホスホン 酸、ホスホセリン、ホスホスレオニン、リン酸ピリドキ サール、ジホスホノメタン、1,2-ジホスホノエタ ン、1,3-ジホスホノプロパン、1,4-ジホスホノ ブタン、1,5-ジホスホノペンタン、1,6-ジホス ホノヘキサン、1、7ージホスホノヘプタン、1、8-ジホスホノオクタン、1,9-ジホスホノノナン、1, 10-ジホスホノデカン、1,11-ジホスホノウンデ カン、1,12-ジホスホノウンデカン、o-フェニレ ンジホスホン酸、mーフェニレンジホスホン酸、pーフ ェニレンジホスホン酸、4,4'-ビフェニレンジホス ホン酸、oーキシリレンジホスホン酸、mーキシリレン ジホスホン酸、pーキシリレンジホスホン酸等が挙げら れる。

【0037】式(2)の化合物の例としては、フェニル ホスフィン酸、ナフチルホスフィン酸、ジフェニルホス フィン酸、ジメチルホスフィン酸、p-ニトロフェニル 40 ホスフィン酸、pーメトキシフェニルホスフィン酸、p ーヒドロキシフェニルホスフィン酸、pートリルホスフ ィン酸、pーアセチルフェニルホスフィン酸、ビスニト ロフェニルリン酸、リン酸ジオクチル、リン酸ジイソプ ロピル、リン酸ジブチルエステル、リン酸ジメチルエス テル、リン酸ジエチルエステル、リン酸ジー2ーエチル ヘキシルエステル、リン酸ジフェニルエステル、メチル ホスフィン酸、エチルホスフィン酸、ジエチルホスフィ ン酸、2-カルボキシエチルホスフィン酸、2-フェニ ルエチルホスフィン酸、2-ヒドロキシエチルホスフィ 50

ン酸、2-メトキシエチルホスフィン酸、2-アセチル エチルホスフィン酸などが挙げられる。

【0038】更に、本発明の有機リン酸系化合物として 次の式(3)で表される化合物も使用することができ る。

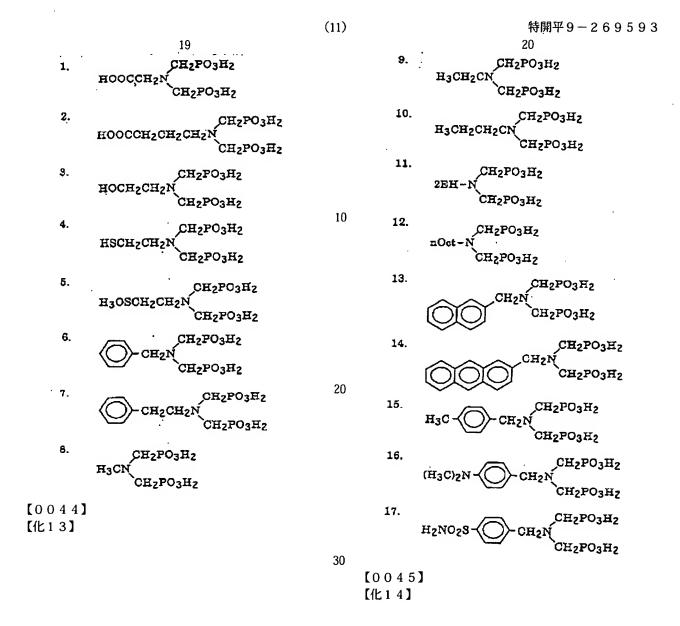
[0039] 【化10】 CH2® •••• (3) CH2®

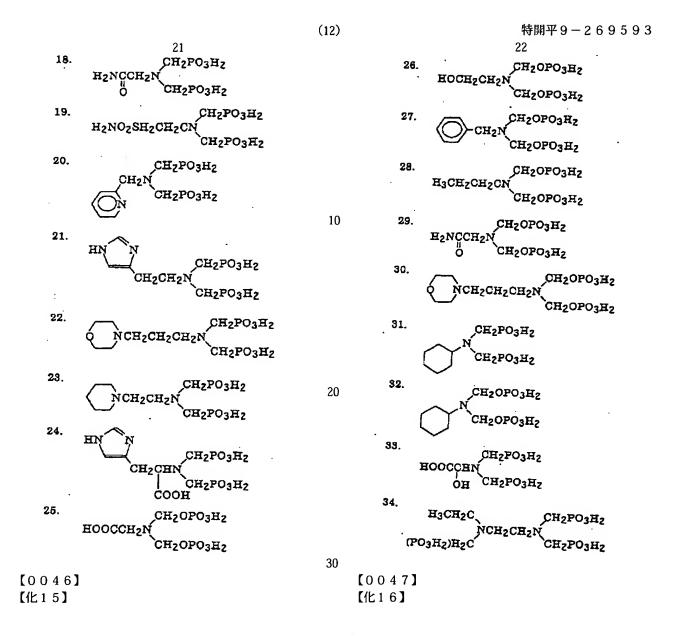
②:-PO3H2又は-OPO3H2又はその塩 R1: 置換益を有していてもよい有機残益

【0040】以下に具体例を示す。但し本発明の範囲 は、これらに限定されるものではない。又具体例の2E Ηは

[0041]【化11】 -CH2CH(CH2)3CH3 (2-エチルヘキシル基) CH2CH3

【0042】nOctはn-C₈H₁₇(n-オクチル 基)を表す。 [0043] 【化12】





[0048] 30 [化17]

25 44. нон₂сн₂с сн₂

HOH2CH2C CH2OPO3H2 NCH2CH2N (PO3H2)H2C CH2OPO3H2

45. H₃C CH₂OPO₃H₂
NCH₂ CH₂OPO₃H₂
(OPO₃H₂)H₂C CH₂OPO₃H₂

47. (PO₃H₂)H₂C CH₂PO₃H₂ CH₂PO₃H₂ (PO₃H₂)H₂C CH₂PO₃H₂

48.
(PO3H2)H2C

NCH2CH2CH2N

(PO3H2)H2C

CH2PO3H2

49. (PO3H2)H2C CH2PO3H2 N(CH2)4N (PO3H2)H2C CH2PO3H2

60. (PO3H2)H2C CH2PO3H2 N(CH2)6N (PO3H2)H2C CH2PO3H2

51. (PO₃H₂)H₂C CH₂PO₃H₂ N(CH₂)₁₂N CH₂PO₃H₂ (PO₃H₂)H₂C CH₂PO₃H₂

52. (PO₃H₂)H₂C CH₂PO₃H₂ CH₂PO₃H₂ (PO₃H₂)H₂C CH₂PO₃H₂

【化18】

[0049]

[0050]

【化19】

CH2PO3H2

COOH

(PO3H2)H2C

62.
$$(PO_3H_2)H_2C$$
 CH_3 $CH_2PO_3H_2$ $NCHCH_2N$ $CH_2PO_3H_2$ $CH_2PO_3H_2$

67.
$$(OPO_3H_2)H_2C$$
 $CH_2OPO_3H_2$ $CH_2OPO_3H_2$ $CH_2OPO_3H_2$

68.
$$(OPO_3H_2)H_2C N - CH_2OPO_3H_2 \\ (OPO_3H_2)H_2C N - CH_2OPO_3H_2$$

[0051]

【化20】

[0052]

【化21】

78.

79.

80.

81.

82.

83.

[0053]

【化22】

85.

86.

$$\begin{array}{c} \text{87.} & \text{(PO_3H_2)H_2C} \\ \text{N-CH-} \\ \text{(PO_3H_2)H_2C} \\ \text{Cl} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{CH_2PO_3H_2} \\ \text{Cl} \\ \end{array}$$

88.

89.

90.

[0054] 【化23】 (PO3H2)H2C

93.

【0055】本発明の有機リン酸系化合物は、SYNTHESI S 81-96 (1976)、「実験化学講座 1 9」 (丸善1957年 刊) 記載のシッフ塩基へのホスホン酸の付加反応、アル コールとオルトリン酸の脱水縮合反応及びアルコールと オキシ塩化リンの縮合反応等により合成することができ

【0056】本発明で使用する分子量1000以下のフ ェノール類及び有機リン酸系化合物を溶解させ、一般式 (I)及び(II)で表わされる化合物を加水分解ととも に重縮合させるための有機溶媒の例は以下のものがあ る。メタノール、エタノール、n-及びi-プロパノー ル、1-及び2-ブタノール、イソブチルアルコール、 アミルアルコール、ペンタノール、フーゼル油、ヘキサ ノール、ヘプタノール、オクタノール、シクロヘキサノ ール、ベンジルアルコール、フルフリルアルコール、テ トラヒドロフルフリルアルコール、ヘキサン、ヘプタ ン、オクタン、デカン、石油エーテル、石油ベンジン、 リグロイン、ガソリン、灯油、シクロヘキサン、ベンゼ

50 ン、トルエン、o-、m-及びp-キシレン、スチレ

ン、クレゾール、テトラリン、デカリン、テレビン油、 クロロホルム、四塩化炭素、塩化メチレン、塩化エチレ ン、塩化エチリデン、トリクロルエタン、テトラクロル エタン、トリクロルエチレン、テトラクロルエチレン、 トリクロルプロパン、塩化イソプロピル、ジクロルプロ パン、塩化ブチル、塩化アミル、塩化ヘキシル、臭化エ チレン、テトラプロムエタン、クロルベンゼン、οージ クロルベンゼン、トリクロルベンゼン、ブロムベンゼ ン、クロルトルエン、ジエチルエーテル、イソプロピル エーテル、ジブチルエーテル、ジイソアミルエーテル、 ヘキシルエーテル、メチルフェニルエーテル、エチルフ ェニルエーテル、ブチルフェニルエーテル、エチルベン ジルエーテル、1、4-ジオキサン、2-メチルフラ ン、テトラヒドロフラン、テトラヒドロピラン、2-エ トキシテトラヒドロピラン、シネオール、アセトン、メ チルエチルケトン、メチルプロピルケトン、メチルブチ ルケトン、メチルイソブチルケトン、メチルアミルケト ン、メチルヘキシルケトン、ジエチルケトン、エチルブ チルケトン、ジプロピルケトン、ジイソブチルケトン、 ジアセトンアルコール、ホロン、イソホロン、シクロへ 20 キサノン、メチルシクロヘキサノン、アセトフェノン、 ギ酸エチル、ギ酸プロピル、ギ酸ブチル、ギ酸イソブチ ル、ギ酸アミル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピ ル、酢酸イソプロピル、酢酸ブチル、酢酸イソブチル、 酢酸第二ブチル、酢酸アミル、酢酸イソアミル、酢酸メ チルイソアミル、酢酸メトキシブチル、酢酸2-エチル ブチル、酢酸ヘキシル、酢酸シクロヘキシル、酢酸ベン ジル、プロピオン酸メチル、プロピオン酸エチル、プロ ピオン酸ブチル、プロピオン酸アミル、酪酸メチル、酪 酸エチル、酪酸ブチル、酪酸アミル、酪酸イソアミル、 アセト酢酸メチル、アセトン酢酸エチル、イソ吉草酸イ ソアミル、乳酸メチル、乳液エチル、乳酸ブチル、乳酸 アミル、安息香酸メチル、シュウ酸ジエチル、エチレン グリコール、エチレングリコールモノメチルエーテル、 エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エ チレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコー ルモノエチルエーテル、エチレングリコールジエチルエ ーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテ ート、エチレングリコールイソプロピルエーテル、エチ レングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコー 40 ルモノイソブチルエーテル、エチレングリコールジブチ ルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテルア セテート、エチレングリコールイソアミルエーテル、エ チレングリコールモノヘキシルエーテル、エチレングリ コールモノフェニルエーテル、エチレングリコールモノ フェニルエーテルアセテート、エチレングリコールベン ジルエーテル、メトキシメトキシエタノール、エチレン グリコールモノアセテート、エチレングリコールジアセ テート、エチレングリコール酪酸モノエステル、エチレ ングリコールプロピオン酸ジエステル、エチレングリコ 50

ール酪酸ジエステル、ジエチレングリコール、ジエチレ ングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコー ルモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチ ルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエメ チルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノイ ソプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノブチル エーテル、ジエチレングリコールモノイソブチルエーテ ル、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテー ト、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレ ングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコール メチルエチルエーテル、ジエチレングリコールアセテー ト、ジエチレングリコールジブチルエーテル、プロピレ ングリコール、プロピレングリコールモノメチルエーテ ル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピ レングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピ レングリコールプロピルエーテル、プロピレングリコー ルモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコー ルモノブチルエーテル、ジプロピレングリコール、ジプ ロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレン グリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコー ルジメチルエーテル、ジプロピレングリコールメチルエ チルエーテル、ジプロピレングリコールジエチルエーテ ル、トリメチレングリコール、トリエチレングリコール ジメチルエーテル、ブタンジオール、ペンタンジオー ル、ヘキシレングリコール、3-メトキシ-3-メトキ シブタノール、ギ酸、酢酸、無水酢酸、プロピオン酸、 無水プロピオン酸、酪酸、吉草酸、乳酸、ピリジン、ピ コリン、キノリン、イソキノリン、ジメチルスルホキシ ド、リン酸トリエチル、ソーブチロラクトン、ソーバレ ロラクトン、6-ヘキサノラクトン、サリチル酸メチ ル、サリチル酸エチル、サリチル酸ブチル、アジピン酸 ジエチル、炭酸エチル、硫化ブチル、アセチルアセト ン、アセトニルアセトン、モノー、ジーおよびトリエタ ノールアミン、N. N-ジメチルホルムアミド、グリセ

【0057】特に好ましいものは、メタノール、エタノール、iープロパノール、ヘキサン、シクロヘキサン、ベンゼン、トルエン、1,4ージオキサン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、エチレングリコールジメチルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、アセチルアセトン、N,Nージメチルホルムアミドおよびモノエタノールアミンである。有機溶媒は単独で使用してもよく、或いは2種以上のものを混合して使用してもよい。本発明のフェノール類又は有機リン酸系化合物が上記有機化合物に溶けないときは、1,4ージオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、ジエチレングリコール、ジメチルスルホキシド、

であり、添加しすぎて無駄になるのを避けることができる。

40

N、N-ジメチルホルムアミド、アセチルアセトンに溶 かしてから上記有機溶媒に混ぜこむ。フェノール類及び 有機リン酸系化合物の使用量は、一般式(I)及び(II) で表される化合物のモル数を基準として1/10~1/ 200倍モルが適当である。一般式(1)及び(II)で 表わされる化合物を有機溶媒中で加水分解する場合、有 機溶媒中に残留して含有されている水をそのまま加水分 解剤として用いることも可能であるが、本発明に従う液 状組成物の調製をある時間内で終了させるように制御す るためには、一般に化合物1モル当り、0.5乃至1, 000モルの水を加えるのが好ましい。水の量がこの範 囲より少ない時は、加水分解とそれに続く重縮合反応の 進行が非常に遅くなり、金属表面処理が可能となるまで に数日を要することがある。一方、水の量がこの範囲よ り多すぎる場合は、生成組成物を金属表面に塗設しても 密着不良をおこすほか、組成物の経時安定性が悪く、す ぐゲル化してしまうことが多いため、塗布作業を安定し て行ないにくくなる。

【0058】水は、加水分解のための反応物質として作 用するほかに、本発明の処理液の溶媒としての役割をも 併せ有することができる。一般式(I)及び(II)で表 わされる化合物の加水分解速度が十分遅くて容易にゲル 化しない条件下では、本発明の方法に従う液状組成物を 水系媒質中で調製することができる。反応温度は室温~ 100℃程度が常用されるが、還流冷却器を付設するこ とによって、溶媒の沸点よりも高い温度で反応させるこ ともできる。反応温度は、加水分解及び重縮合反応に要 する時間を決定する。常温で数日かかる反応であれば、 80℃では数時間で終了するので、目的に応じて適当に 設定する。必要に応じて使用される触媒としては、塩 酸、硫酸、リン酸、酢酸などの酸、又はアンモニア、テ トラメチルアンモニウムヒドロキシドなどの塩基が使用 できる。触媒の添加量は、一般に一般式(I)及び(I I) で表わされる化合物 1 モル当り 0.0 1 モルないし 0. 1モル程度である。ただし、0. 1モル以上の方が 好適な場合もある。触媒添加量は多くても1モルが適当

【0059】触媒の添加は、触媒そのものを単体で加え る方法のほか、触媒溶液を加える方法によっても行なう ことができる。例えば、塩酸をそのまま加える代わり に、塩酸の無水メタノール溶液を加えてもよい。また、 テトラメチルアンモニウムヒドロキシドも、例えば水溶 液やエタノール溶液として使用することができる。一般 式(I)及び(II)で表わされる1種もしくはそれ以上 の化合物、有機溶媒、水、及び場合により触媒からなる 組成物を、適当な反応温度、反応時間、及び場合により 適当な攪拌条件を選んで反応させると、加水分解ととも に重縮合反応がおこり、金属一酸素-金属の結合を含む 高分子又はコロイド状高分子が生成し、液状組成物の粘 度が上昇し、ゾル化する。こうして得られたゾルを重合 させてゲルとし、これを400~1000℃に加熱する とガラスができるが、この方法はゾルゲル法としてよく 知られている。ガラス生成反応を別の基板上で行なわせ ると、酸化物皮膜を塗設できることも公知である。

【0060】本発明に従う方法においては、1)上記ゾルの中に存在している金属一酸素一金属結合からなる無機高分子を被処理金属表面と結合させて、該無機高分子を被処理金属表面と結合させて、該無機高分子に共有結合的に固定している有機反応性基を被処理金属表面上に植えつけ、2)フェノール化合物又は有機リン酸系化合物の一つの基又は複数の基が上記無機高分子の結合の酸素の位置に配位もしくは結合して、被処理金属表面に塗設する液体組成物の架橋および塗設後のゾルの架橋を阻害し、3)更にこの化合物は現像時の非画像部からは溶出してなくなるためゾルゲルの架橋性のコントロールを可能とするものであり、金属表面にフェノール化合物又は有機リン酸系化合物を恒久的に設けることを目的とするものではない。この関係をシリコン及びフェノール化合物としてカテコールを例にとり模式的に表すと以下のようになると考えられる。

【0061】 【化24】

【0062】本発明において用いられるゾル液もしくは 液状組成物は、支持体表面に塗設後、風乾ないし加熱乾 燥させると、金属-酸素-金属結合からなる無機高分子 がゲル化すると同時に支持体表面と共有結合する。乾燥 は溶媒、残留水及び場合により触媒を揮散させるために 行なうものであるが、処理後の支持体の使用目的によっ ては工程を省くこともできる。本発明に従う液状組成物 中の無機高分子部分と被処理金属表面との間の密着性を 高めるため、積極的に温度をかけることもできる。この 場合の乾燥工程は、溶媒、水等の揮散後も継続して実施 し得る。乾燥及び場合により継続されるその後の加熱に おける最高温度は金属表面に植え付けられた官能基 ((I)式のA)が分解しない範囲にあることが好まし い。従って、使用できる乾燥温度条件は室温~200 ℃、好ましくは室温~150℃、更に好ましくは室温~ 120℃である。乾燥時間は一般に30秒~30分間、 好ましくは45秒~10分間、更に好ましくは1分~3

分間である。本発明において用いられる液状組成物(有 50

機シリコーン化合物もしくはその溶液又はゾル液)の施 工方法は、ハケ塗り、浸漬塗布、アトマイジング、スピ ンコーティング、ドクターブレード塗布等、各種のもの も使用することができ、支持体表面の形状や必要とする 処理膜厚等を勘案して決められる。支持体が金属板であ る場合、その金属表面を処理する時は、油状物などが付 着していない清浄な面であることが好ましいが、油状物 などの付着により著しく汚染されている場合を除き、そ のままの状態で用いることができる。必要に応じて、機 械的に凹凸をつけたものや、電解析出、電解エッチング 等によって金属表面を粗面化してもよい。また、金属表 面に自然酸化皮膜の生成したもの、又は陽極酸化、接触 酸化等によって積極的に表面を酸化させたものも好適に 使用し得る。地金金属とは別種の酸化物皮膜を溶射、塗 布、CVD法等によって表面に設けたものも勿論使用し 得る。酸化物ばかりではなく、例えば表面シリケート処 理、表面窒化処理等によって、金属表面とは別種の表面 層が設けられたものも使用し得る。

【0063】支持体としては、印刷機にかけるのに十分 な強度を有するシート状のものが使用される。このよう な支持体としては、例えば、金属板、ポリエステルシー ト、ポリイミドシート、強化紙などを挙げることができ る。高速かつ大部数印刷のための印刷版を得る目的では 金属板を基板として用いるのが好ましく、中でもアルミ ニウム板を常法で脱脂したものを使用するのが好まし い。本発明において用いられるアルミニウム板は純アル ミニウム又はアルミニウムを主成分とし微量の異原子を 含むアルミニウム合金等の板状体である。この異原子に 10 は、ケイ素、鉄、マンガン、銅、マグネシウム、クロ ム、亜鉛、ビスマス、ニッケル、チタン等がある。合金 組成としては、10重量%以下の異原子含有率のもので ある。本発明に好適なアルミニウムは、純アルミニウム であるが、完全に純粋なアルミニウムは、製錬技術上製 造が困難であるので、できるだけ異原子を含まないもの がよい。また、上述した程度の異原子含有率のアルミニ ウム合金であれば、本発明に使用しうる素材ということ ができる。このように本発明に使用されるアルミニウム 板は、その組成が特に限定されるものではなく、従来公 知、公用の素材のものを適宜利用することができる。好 ましい素材としては、JIS A 1050、同110 0、同1200、同3003、同3103、同3005 が含まれる。本発明に用いられるアルミニウム板の厚さ は、約0.1㎜~0.5㎜程度である。

43

【0064】アルミニウム板は、表面の圧延油を除去す るための、例えば界面活性剤又はアルカリ性水溶液で処 理する脱脂処理、砂目立処理、陽極酸化処理、及び親水 化処理が所望により行われる。砂目立て処理方法には、 機械的に表面を粗面化する方法、電気化学的に表面を溶 解する方法及び化学的に表面を選択溶解させる方法があ る。機械的に表面を粗面化する方法としては、ボール研 摩法、ブラシ研摩法、ブラスト研摩法、バフ研摩法等の 公知の方法を用いることができる。また、電気化学的な 粗面化法としては塩酸又は硝酸電解液中で交流又は直流 により電解を行って粗面化する方法がある。また、特開 昭54-63902号公報に開示されているように両者 を組合せた方法も利用することができる。このようにし て粗面化されたアルミニウム板は、必要に応じてアルカ リエッチング処理及び中和処理される。

【0065】アルミニウム板の陽極酸化処理に用いられ る電解質としては多孔質酸化皮膜を形成しえるものであ ればいかなるものでも使用することができる。一般には 硫酸、リン酸、蓚酸、クロム酸あるいはそれらの混酸が 用いられ、それらの電解質の濃度は電解質の種類によっ て適宜決められる。陽極酸化の処理条件は、用いる電解 質により種々変わるので一概に特定し得ないが、一般的 には電解質の濃度が1~80重量%、液温が5~70 ℃、電流密度が5~60A/dm²、電圧が1~100V、 電解時間が10秒~50分の範囲にあれば適当である。

これらの陽極酸化処理の内でも、特に英国特許第1,4 12,768号明細書に記載されている硫酸中で高電流 密度で陽極酸化する方法及び米国特許第4.211.6 19号明細書に記載されているような低濃度の硫酸中で 陽極酸化する方法が好ましい。最も好ましくは5~20 重量%の硫酸と3~15重量%のアルミニウムイオンを 含有する、温度25~50℃の電解液中で電流密度5~ 20 A/dm²の直流で溶極酸化する方法である。陽極酸化

皮膜の量は $0.1\sim10$ g/ n^2 とすることができる。

44

【0066】親水化処理としては、アルカリ金属珪酸塩 の水溶液による処理、有機ホスホン酸水溶液による処理 が好ましい。アルカリ金属珪酸塩が1~30重量%、好 ましくは2~15重量%であり、25℃のpHが10~ 13である水溶液に、例えば15~80℃で0.5~1 20秒浸漬する。本発明に用いられるアルカル金属珪酸 塩としては、珪酸ナトリウム、珪酸カリウム、珪酸リチ ウムなどが使用される。アルカリ金属珪酸塩水溶液のp Hを高くするために使用される水酸化物としては水酸化 ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウムなどがあ る。なお、上記の処理液にアルカリ土類金属塩もしくは 第IVB族金属塩を配合してもよい。アルカリ土類金属塩 としては、硝酸カルシウム、硝酸ストロンチウム、硫酸 マグネシウム、硝酸バリウムのような硝酸塩や、硫酸 塩、塩酸塩、燐酸塩、酢酸塩、蓚酸塩、ホウ酸塩などの 水溶性の塩が挙げられる。第IVB族金属塩として、四塩 化チタン、三塩化チタン、フッ化チタンカリウム、蓚酸 チタンカリウム、硫酸チタン、四ヨウ化チタン、塩化酸 化ジルコニウム、二酸化ジルコニウム、オキシ塩化ジル コニウム、四塩化ジルコニウムなどを挙げることができ る。アルカリ土類金属塩もしくは、第IVB族金属塩は単 独又は2以上組み合わせて使用することができる。これ らの金属塩の好ましい範囲は0.01~10重量%であ り、更に好ましい範囲は0.05~5.0重量%であ る。

【0067】支持体上の付加反応性官能基の量は、結合 させる付加反応性官能基の種類によって異なるが、10 0 Å^2 当り一般に $0.01 \sim 400 \text{ 個}$ 、好ましくは0.05~40個、更に好ましくは0.1~5個とすること が適当である。付加反応性官能基量が100Å・当り 0.01個より少ないと十分な光接着強度が得られ難 い。本発明に従うゾル液もしくは液状組成物を厚く塗り 重ねることによって100Å′当りの付加反応性官能基 量を実質的に幾らでも多くすることが可能であるが、最 表面に顔を出す付加反応性官能基量は100Å2当り高 々10個であるので、厚く塗り過ぎても無駄になる。付 加反応性官能基量が多過で、PS版として使用した時の 非画像部の親水性が不足しないためには、100Å2当 りの付加反応性官能基の量は400個以内とするのが好 ましい。

【0068】支持体表面に保持される付加反応性官能基 50

の量は、支持体処理後の表面を適当な方法、例えばケイ 光X線分析法、赤外線吸収法等の方法で測定し、表面に あるSi原子量の定量、炭素-炭素の多重結合量の定量 等を行なうことによって決定することができる。付加反 応性官能基を結合した支持体(付加反応性支持体)を用 いてPS版を構成する場合、一般式(II)の有機シリコ ーン化合物のみを原料として調製したゾル液を用いて支 持体の処理をしただけでは印刷汚れを生じる場合があ る。即ち、付加反応性官能基を結合した支持体上に、一 般に光重合性の感光性組成物を塗布して感光層を設け、 これに像様露光することにより、画像通りの界面光接着 を起させた後、現像液で未露光部を取り去ると、支持体 上には光のパターン通りの光重合密着膜が残る。そし て、これにインクと水を塗ると、インクは光重合接着し た像様露光部へ、水は未露光部へそれぞれ付着する。そ こで、これを印刷版として使用すると、上記有機シリコ ーン化合物を単独の原料として使用する場合、水が付着 するべき未露光部に、過剰の有機官能基が存在しやすい ため、水の他にインクも付着して、印刷物上に汚れとな って観察されることがある。従って、この印刷汚れを防 ぐために、支持体表面上に付加反応性官能基(A')の 他にOH基を多く固定して親水性を強くすることが好ま しい。好ましくは、ゾル液の調製において、一般式(I 1) で表わされる有機シリコーン化合物の他に、式 (5):Si(OR4)4(式中、-OR4は加水分解可 能なアルコキシ基、アルコキシアルコキシ基、アリール オキシ基又は一〇СОСН3基である。) で表わされる 有機シリコーン化合物(5)を併用し、支持体表面に式 (4):

【0070】で示される反応サイトを結合すると同時 に、式(6): 【0071】 【化26】 OH

$$R_{3}O - S_{1} - OR_{3}$$
 (6)

【0072】で示される親水性サイトを結合することが 好ましい。ここで、式中、 R_3 はアルキル基、水素原 子、又は隣接する別の S_i 原子との結合を表わすが、 R_3 が水素原子であることが親水性の面からは最も好ましい。なお、 R_3 が水素原子以外のもののときは、必要に 応じて、表面をアルカリ溶液で洗うことによって、親水性を高めることができる。支持体表面への付加反応性官 能基の結合には、有機シリコーン化合物を加水分解する とともに重縮合させて得られた $-S_i-O-S_i$ ー結合 50 ましくは1-100 モル、更に好ましくは1.5-10 モルである。水の量が有機シリコーン化合物1 モル当り100 モル当り 100 モルより 学校 本名までに数日を要し好ましくない。一方、水の量が有機シリコーン化合物1 モル当り 100 モルより をくなると、生成した組成物を金属表面に塗設した場合 密着不良を起す他、組成物の経時安定性が悪く、すぐに ゲル化してしまうことが多いため、塗布作業を安定して

を含む無機高分子に付加反応性官能基が固定された形の 有機無機複合体を用いることからなる上述の方法(以 下、SG法と呼ぶ)が好適に利用できる。この有機無機 複合体を支持体に塗布して乾燥させると、支持体が金属 やその酸化物の場合、無機高分子部分が基板と密着し、 付加反応性官能基はそのまま支持体表面上に残る。

46

【0073】SG法による付加反応性官能基の結合法に 従えば、一般式(II)の有機シリコーン化合物を、場合 により式(5)の有機シリコーン化合物と所望の混合比 に混合し、液中で、必要により触媒の存在下で、付加反 応性官能基R1では反応を起さずに-OR2及び-OR4 で加水分解させるとともに重縮合反応を行なわせて、中 心のSi原子が-Si-O-Si-結合でつながった無 機高分子を含む液状組成物として、これを支持体表面に 塗布し、場合により乾燥させることによって支持体上に 付加反応性官能基を結合する。SG法を用いると、支持 体表面上に結合固定される付加反応性官能基の分布が支 持体表面の酸点や塩基点などの化学的な性質の分布に左 右されることが少ない。また、出発原料として一般式 (II) の有機シリコーン化合物の他に式(5)の有機シ リコーン化合物を併用する場合、上記式(4)で示され る付加反応性官能基サイトと上記式(6)で示される親 水性サイトとの相対比が一般式(II)の有機シリコーン 化合物及び式(5)の化合物の仕込み比でほぼ決めるこ とができる。

【0074】SG法の場合、付加反応性官能基が保持さ れた無機高分子組成物を予かじめ調液しておく必要があ る。以下にその好ましい具体例を示す。一般式(II)及 び(5)で表わされる有機シリコーン化合物を加水分解 とともに重縮合させてSG法に好適な組成物とするのに 使用できる溶媒は、メタノール、エタノール、プロパノ ール、イソプロパノール、エチレングリコール、ヘキシ レングリコール等のアルコール類である。溶媒の使用量 は、使用する有機シリコーン化合物の総重量に基づい て、一般に0.2~500倍、好ましくは0.5~50 倍、更に好ましくは1~3倍である。使用量が0.2倍 より少ないと反応液が経時でゲル化しやすく不安定とな り好ましくない。また、500倍より多いと、反応が数 日を要するようになり好ましくない。有機シリコーン化 合物を加水分解するために加える水の量は、一般に有機 シリコーン化合物1モル当り0.5~1000モル、好 ましくは1~100モル、更に好ましくは1.5~10 モルである。水の量が有機シリコーン化合物 1 モル当 り、0.5モルより少ない時は、加水分解とそれに続く 重縮合反応の進行が非常に遅くなり、安定な表面処理が 可能となるまでに数日を要し好ましくない。一方、水の 量が有機シリコーン化合物1モル当り1000モルより 多くなると、生成した組成物を金属表面に塗設した場合 密着不良を起す他、組成物の経時安定性が悪く、すぐに

行ないにくくなる。

【0075】SG法に好適な組成物を調液するための反 応温度は室温~100℃程度が常用されるが、以下に述 べる触媒の種類によっては室温以下あるいは100℃以 上の温度を用いることもできる。溶媒の沸点よりも高い 温度で反応させることも可能であり、必要に応じて反応 器に還流冷却器を付設するのがよい。必要に応じて使用 される触媒としては、塩酸、硫酸、硝酸、リン酸、酢 酸、リンゴ酸、シュウ酸などの酸、又はアンモニア、テ トラメチルアンモニウムヒドロキシド、水酸化カリウ ム、水酸化ナトリウムなどの塩基が使用できる。触媒の 添加量は、一般式(II)の有機シリコーン化合物及び場 合により追加される式(5)の有機シリコーン化合物の 合計量を基準として、有機シリコーン化合物 1 モル当り 0.001~1モル、好ましくは0.002~0.7モ ル、更に好ましくは0.003~0.4モルである。触 媒添加量を1モルより多くしても、その添加効果に比べ て経済的に特に利益があるわけではない。

【0076】酢酸、リンゴ酸等の弱酸を触媒として使用 する時は、反応温度を40℃~100℃の範囲とするの が有利であるが、硫酸、硝酸等の強酸を触媒として使用 する時は10℃~60℃の範囲がよい。リン酸を触媒と して用いる場合は10℃~90℃で反応を行なわせるこ とができる。SG法に用いる組成物の調液工程、及びこ れを基板に塗布し乾燥する工程で、多くの場合熱が加え られるが、揮発性の酸を触媒として使用すると、周囲の 装置に揮発して付着し、これを腐食させる場合がある。 主として鉄を素材として用いる工程で本方法を使用する 場合は、不揮発性の硫酸及び/又はリン酸を触媒として 用いるのが好ましい。以上述べたように、一般式(II) 及び(5)で表わされる有機シリコーン化合物と、有機 溶媒、水、及び場合により触媒からなる組成物を、適当 な反応温度、反応時間、及び場合により適当な攪拌条件 を選んで反応させると、加水分解とともに重縮合反応が 起りSi-〇-Si結合を含む高分子又はコロイド状高 分子が生成し、液状組成物の粘度が上昇し、ゾル化す る。一般式(II)及び(5)で表わされる有機シリコー ン化合物を両方使用してゾル液を調製する場合、両方の 有機シリコーン化合物を反応の最初から反応容器内に装 荷してもよく、あるいは一方のみで加水分解と重縮合反 40 応をある程度進めた後に他方の有機シリコーン化合物を 加え、反応を終了させてもよい。SG法で用いる上記ゾ ル液は、室温で放置すると重縮合反応が引き続き進行 し、ゲル化することがある。従って、一度上記の方法で 調液したゾル液を、支持体塗布時の希釈に使用する予定 の溶媒で予じめ希釈して、ゾル液のゲル化を防止ないし 遅延させることができる。

【0077】支持体上に目的量の有機シリコーン化合物 もしくは付加反応性官能基を結合するために、また支持 体上での有機シリコーン化合物もしくは付加反応性官能 50

基の分布ムラが無いようにするために、これらの処理液 を支持体に塗布する前に溶媒を加えて濃度調整を行なう ことが好ましい。この目的に使用する溶媒としてはアル コール類、殊にメタノールが好適であるが、他の溶剤、 有機化合物、無機添加剤、界面活性剤などを加えること もできる。他の溶剤の例としては、メチルエチルケト ン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレン グリコールモノエチルエーテル、2-メトキシエチルア セテート、1ーメトキシー2ープロピルアセテート、ジ メトキシエタン、乳酸メチル、乳酸エチル、アセチルア セトン、エチレングリコール等を挙げることができる。 添加することのできる有機化合物の例としては、エポキ シ樹脂、アクリル樹脂、ブチラール樹脂、ウレタン樹 脂、ノボラック樹脂、ピロガロールーアセトン樹脂、ポ リビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、ポリビニ ルメチルエーテル、ポリプロピレングリコール等が挙げ られる。無機添加剤の例としては、コロイダルシリカ、 コロイダルアルミナなどを挙げることができる。エチレ ングリコール、エチレングリコールモノメチルエーテル 等の高沸点溶剤は、支持体に塗布する濃度にまで希釈さ れた液の安定性を高め、支持体に結合された付加反応性 官能基の反応再現性を保証する働きがある。ノボラック 樹脂、ピロガロールーアセトン樹脂等の有機化合物も同 様の効果を有するが、得られる支持体の表面の親水性を 低下させる副作用があり、添加量を細かく調整する必要 がある。

【0078】以上述べた方法により、ラジカルによって付加反応を起し得る官能基を支持体上に共有結合により結合できるので、この上に400~1000mmの光に対して感度を有する高感度光重合性感光層を塗設することによって、感光層/支持体密着力の優れたレーザ光感光性の高感度PS版を構成することができる。即ち、細くビームを絞ったレーザ光をその版面上に走査させ、レーザ光の当った部分にラジカルを発生させ、そのラジカルによって感光層を重合させるとともに感光層と、支持体表面上に結合された付加反応性官能基との界面でも付加反応を起させ、文字原稿、画像原稿などの原稿通りの重合パターンを直接版面上に形成させ、残りの部分をアルカリ水溶液もしくは有機アルカリ溶液もしくは場合により水で溶出除去することによって印刷版を得ることができる。

【0079】(A)光重合性組成物

本発明に従い、付加反応性官能基を結合した支持体の上に塗布される可視光に対して感度を有する高感度光重合性組成物としては、例えば下記に示す(i)~(iv)からなる組成物が好ましいが、400~1000mの光に対して感光する高感度な光重合性感光性組成物であれば本発明の範囲はそれに限定されるものではない。

(i)付加重合性不飽和結合を有する重合可能な化合物、(ii)線状有機高分子重合体、(iii)光開始剤、及

び(iv)400~1000m、好ましくは400~750mの放射線を吸収することができ、かつ前記光開始剤(iii)を分光増感する増感剤。レーザ光露光可能な光重合性組成物は必要に応じて更に下記(イ)、(ロ)及び(ハ)からなる群から選ばれた化合物(v)を含有することができる。

【0080】(イ) R^1R^2N - を有する化合物 R^1 及び R^2 は水素原子、炭素数 $1 \sim 18$ のアルキル基も しくは置換基として、 $-0R^3$ 、 $-CO-R^3$ 、 $-CO-R^3$ 、 $-CO-R^3$ 、 $-CO-R^3$ 、 $-NH-CO-R^3$ (B) R^3 、 R^3 は R^3 に R^3 は R^3 は R^3 に R^3 は R^3 に R^3 に

(ロ) 下記一般式 (5) で示されるチオ化合物 【0081】 【化27】

$$\begin{array}{cccc}
R^{4} & NH & R^{4} & N \\
R^{5} & C = S & R^{5} & C - SH
\end{array}$$
(7)

【0082】 (ハ) 下記一般式 (6) で表される化合物 【0083】

【化28】

$$R^{7} - R^{6} - R^{9}$$
 Z^{+} (8)

【0084】式中、 R^4 はアルキル基又は置換アルキル基、アリール基又は置換アリール基を示し、 R^5 は水素原子又はアルキル基又は置換アルキル基を示す。また、 R^4 と R^5 は、互いに結合して酸素、硫黄及び窒素原子から選ばれたヘテロ原子を含んでもよい5員ないし7員環を形成するのに必要な非金属原子群を示す。 R^6 、 R^7 、 R^8 及び R^9 は互いに同一でも異なっていてもよく、それぞれ置換又は非置換のアルキル基、置換又は非置換のアリール基、置換又は非置換のアルケニル基、置換又は非置換のアリール基、置換又は非置換のアルケニル基、もしくは置換又は非置換の複素環 40基を示し、 R^6 、 R^7 、 R^8 及び R^9 はその2個以上の基が結合して環状構造を形成してもよい。ただし、 R^6 、 R^7 、 R^8 及び R^9 のうち、少なくとも1つはアルキル基である。 Z^4 はアルカリ金属カチオン又は第4級アンモニウムカチオンを示す。

【0085】以下、本発明おいて使用することができる 光重合性組成物の各成分について詳しく説明する。付加 重合性不飽和結合を有する重合可能な化合物(成分

(i))は、末端エチレン性不飽和結合を少なくとも1 ジイタコネート、テトラメチレングリコールジイタコネ 個、好ましくは2個以上有する化合物から選ばれる。例 50 ート、ペンタエリスリトールジイタコネート、ソルビト

えばモノマー、プレポリマー、即ち2量体、3量体及び オリゴマー、又はそれらの混合物、並びにそれらの共重 合体などの化学的形態を持つものである。モノマー及び その共重合体の例としては、不飽和カルボン酸(例え ば、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、クロトン 酸、イソクロトン酸、マレイン酸など)と脂肪族多価ア ルコール化合物とのエステル、不飽和カルボン酸と脂肪 族多価アミン化合物とのアミド等が挙げられる。脂肪族 多価アルコール化合物と不飽和カルボン酸とのエステル のモノマーの具体例としては、アクリル酸エステルとし て、エチレングリコールジアクリレート、トリエチレン グリコールジアクリレート、1,3-ブタンジオールジ アクリレート、テトラメチレングリコールジアクリレー ト、プロピレングリコールジアクリレート、ネオペンチ ルグリコールジアクリレート、トリメチロールプロパン トリアクリレート、トリメチロールプロパントリ(アク リロイルオキシプロピル) エーテル、トリメチロールエ タントリアクリレート、ヘキサンジオールジアクリレー ト、1,4-シクロヘキサンジオールジアクリレート、 20 テトラエチレングリコールジアクリレート、ペンタエリ スリトールジアクリレート、ペンタエリスリトールトリ アクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレー ト、ジペンタエリスリトールジアクリレート、ジペンタ エリスリトールヘキサアクリレート、ソルビトールトリ アクリレート、ソルビトールテトラアクリレート、ソル ビトールペンタアクリレート、ソルビトールヘキサアク リレート、トリ (アクリロイルオキシエチル) イソシア ヌレート、ポリエステルアクリレートオリゴマー等が挙 げられる。

【0086】メタクリル酸エステルとしては、テトラメ チレングリコールジメタクリレート、トリエチレングリ コールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメ タクリレート、トリメチロールプロパントリメタクリレ ート、トリメチロールエタントリメタクリレート、エチ レングリコールジメタクリレート、1.3ーブタンジオ ールジメタクリレート、ヘキサンジオールジメタクリレ ート、ペンタエリスリトールジメタクリレート、ペンタ エリスリトールトリメタクリレート、ペンタエリスリト ールテトラメタクリレート、ジペンタエリスリトールジ メタクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサメタク リレート、ソルビトールトリメタクリレート、ソルビト ールテトラメタクリレート、ビス〔p-(3-メタクリ ルオキシ-2-ヒドロキシプロポキシ)フェニル〕ジメ チルメタン、ビスー [p-(アクリルオキシエトキシ) フェニル] ジメチルメタン等が挙げられる。イタコン酸 エステルとしては、エチレングリコールジイタコネー ト、プロピレングリコールジイタコネート、1,3-ブ タンジオールジイタコネート、1,4-プタンジオール ジイタコネート、テトラメチレングリコールジイタコネ

ールテトラメタクリレート等が挙げられる。クロトン酸 エステルとしては、エチレングリコールジクロトネー ト、テトラメチレングリコールジクロトネート、ペンタ エリスリトールジクロトネート、ソルビトールテトラジ クロトネート等が挙げられる。イソクロトン酸エステル としては、エチレングリコールジイソクロトネート、ペ ンタエリスリトールジイソクロトネート、ソルビトール テトライソクロトネート等が挙げられる。マレイン酸エ ステルとしては、エチレングリコールジマレート、トリ エチレングリコールジマレート、ペンタエリスリトール ジマレート、ソルビトールテトラマレート等が挙げられ

51

【0087】更に、前述のエステルモノマーの混合物を 挙げることができる。また、脂肪族多価アミン化合物と*

 $CH_2 = C(R)COOCH_2CH(R')OH$

(ただし、R及びR'はHあるいはCH3を示す。) また、特開昭51-37193号公報に記載されている ようなウレタンアクリレート類、特開昭48-6418 3号、特公昭49-43191号、特公昭52-304 90号各公報に記載されているようなポリエステルアク リレート類、エポキシ樹脂と(メタ)アクリル酸を反応 させたエポキシアクリレート類等の多官能のアクリレー トやメタクリレートを挙げることができる。更に日本接 着協会誌vol. 20、No. 7、300~308ページ(1 984年)に光硬化性モノマー及びオリゴマーとして紹 介されているものも使用することができる。なお、これ らの使用量は、全成分に対して一般に5~50重量% (以下、単に「%」と略称する)、好ましくは10~4 0%である。

【0088】本発明において使用することができる線状 30 有機高分子重合体(成分(ii))としては、付加重合性 不飽和結合含有化合物(成分(i))と相溶性の線状有 機高分子重合体である限りどのようなものを使用しても よい。好ましくは、イオウラジカルにより容易に水素を 引き抜かれる基を有する線状有機高分子重合体が選択さ れ、好ましくは、水現像あるいは弱アルカリ水現像を可 能とする水あるいは弱アルカリ水可溶性又は膨潤性であ る線状有機高分子重合体が選択される。線状有機高分子 重合体は、該組成物の皮膜形成剤として機能し、使用す る現像剤、即ち水、弱アルカリ水あるいは有機溶剤現像 40 剤の現像剤の種類に応じて選択使用される。例えば、水 可溶性有機高分子重合体を用いると水現像が可能にな る。このような線状有機高分子重合体としては、側鎖に カルボン酸基を有する付加重合体、例えば特開昭59ー 44615号、特公昭54-34327号、特公昭58 -12577号、特公昭54-25957号、特開昭5 4-92723号、特開昭59-53836号、特開昭 59-71048号の各公報に記載されているもの、即 ち、メタクリル酸共重合体、アクリル酸共重合体、アク リル酸共重合体、イタコン酸共重合体、クロトン酸共重 50

*不飽和カルボン酸とのアミドのモノマーの具体例として は、メチレンビスーアクリルアミド、メチレンビスーメ タクリルアミド、1,6-ヘキサメチレンビス-アクリ ルアミド、1、6-ヘキサメチレンビス-メタクリルア ミド、ジエチレントリアミントリスアクリルアミド、キ シリレンビスアクリルアミド、キシリレンビスメタクリ ルアミド等が挙げられる。その他の例としては、特公昭 48-41708号公報中に記載されている1分子に2 個以上のイソシアネート基を有するポリイソシアネート 化合物に、下記の一般式(A)で示される水酸基を含有 するビニルモノマーを付加した1分子中に2個以上の重 合性ビニル基を含有するビニルウレタン化合物等が挙げ られる。

52

(A)

合体、マレイン酸共重合体、部分エステル化マレイン酸 共重合体などがある。また側鎖にカルボン酸基を有する 酸性セルロース誘導体も挙げられる。この他に水酸基を 有する付加重合体に環状無水物を付加させたものなども 有用である。特にこれらの中で〔ベンジル(メタ)アク リレート/(メタ)アクリル酸/必要に応じてその他の 付加重合性ビニルモノマー〕共重合体及び〔アリル(メ タ)アクリレート/(メタ)アクリル酸/必要に応じて その他の付加重合性ビニルモノマー〕共重合体が好適で ある。この他に水溶性線状有機高分子として、ポリビニ ルピロリドンやポリエチレンオキサイド等が有用であ る。また硬化皮膜の強度を上げるためにアルコール可溶 性ナイロンや2、2-ビス-(4-ヒドロキジフェニ ル) -プロパンとエピクロロヒドリンのポリエーテル等 も有用である。線状有機高分子重合体(成分(ii)) は、その主鎖もしくは側鎖に、好ましくはイオウラジカ ルにより容易に水素を引き抜かれる基、好ましくは、メ チルラジカルにより水素を引き抜いた場合にトルエンの メチル基よりも容易に引き抜くことができる基、更に好 ましくは、 R^{10} R^{11} $C = CH - CHR^{12}$ -、 $-CHR^{13}$ Ari

[0089]

【化29】

(*)* / .

【0090】 - C₆ H₄ C H A r₂ A r₃ 又は

[0091]

【化30】

【0092】を有するものである。式中、R¹⁰、R¹¹、 R"及びR"は水素原子、アルキル基、アルケニル基又 は置換されていてもよいアリール基、Ari、Arz及び Ar₃は置換されていてもよいアリール基を示す。これ

らの線状有機高分子重合体は全組成物中に任意な量で混和させることができる。しかし、溶剤重量を除いた全組成物の重量を基準として90%を越える場合には形成される画像強度等の点で好ましい結果を与えない。従って、線状有機高分子重合体の量は、一般に20~90%、好ましくは30~80%である。また光重合可能なエチレン性不飽和化合物(成分(i))と線状有機高分子重合体(成分(ii)は、重量比で一般に1/9~7/3、好ましくは3/7~5/5である。

53

【0093】本発明において使用することができる光開 10 始剤(成分(iii))としては、ベンジル、ベンゾイン、 ベンゾインエーテル、ミヒラーケトン、アントラキノ ン、アクリジン、フェナジン、ベンゾフェノン、2-エ チルアントラキノン、トリハロメチルトリアジン化合 物、ケトオキシムエステルなど、また、米国特許第2, 850,445号明細書に記載の光還元性染料、例えば ローズベンガル、エオシン、エリスロシンなど、あるい は、染料と開始剤との組合せによる系、例えば、染料と アミンの複合開始系(特公昭44-20189号公報な ど)、ヘキサアリールビイミダゾールとラジカル発生剤 及び染料の系(特公昭45-37377号公報など)、 ヘキサアリールビイミダゾールとpージアルキルアミノ ベンジリデンケトンの系(特公昭47-2528号、特 開昭54-155292号公報など)、染料と有機過酸 化物の系(特公昭62-1641号、特開昭59-15 04号、特開昭59-140203号、特開昭59-1 89340号公報、米国特許第4,766,055号明 細書、特開昭62-174203号公報など)、染料と 活性ハロゲン化合物の系(特開昭54-15102号、 特開昭58-15503号、特開昭63-178105 号、特開昭63-258903号、特開平2-6305 4号公報など)、染料とボレート化合物の系(特開昭6 2-143044号、特開昭62-150242号、特 開昭64-13140号、特開昭64-13141号、 特開昭64-13142号、特開昭64-13143 号、特開昭64-13144号、特開昭64-1704 8号、特開昭64-72150号、特開平1-2290 03号、特開平1-298348号、特開平1-138 204号、特開平2-179643号、特開平2-24 4050号公報など) などが挙げられる。

【0094】上記へキサアリールビイミダゾールとしては、2, 2' ービス (o ークロロフェニル) ー 4, 4', 5, 5' ーテトラフェニルビイミダゾール、2, 2' ービス (o ーブロモフェニル) ー 4, 4', 5, 5' ーテトラフェニルビイミダゾール、2, 2' ービス (o, p ージクロロフェニル) ー 4, 4', 5, 5' ーテトラフェニルビイミダゾール、2, 2' ービス (o ークロロフェニル) ー 4, 4', 5, 5' ーテトラ (m ーメトキシフェニル) ビイミダゾール、2, 2' ービス (o, o' ージクロロフェニル) ー 4, 4', 5, 5'

ーテトラフェニルビイミダゾール、2, 2' ービス (o -ニトロフェニル) - 4 , 4 ' , 5 , 5 ' -テトラフェ ニルビイミダゾール、2,2'ービス(oーメチルフェ ニル) -4, 4', 5, 5'-テトラフェニルビイミダ ゾール、2,2'-ビス(o-トリフルオロメチルフェ ニル) - 4, 4', 5, 5' - テトラフェニルビイミダ ゾール等が挙げられる。ケトオキシムエステルとして は、3-ベンゾイロキシイミノブタン-2-オン、3-アセトキシイミノブタン-2-オン、3-プロピオニル オキシイミノブタン-2-オン、2-アセトキシイミノ ペンタン-3-オン、2-アセトキシイミノ-1-フェ ニルプロパン-1-オン、2-ベンゾイロキシイミノー 1-フェニルプロパン-1-オン、3-p-トルエンス ルホニルオキシイミノブタン-2-オン、2-エトキシ カルボニルオキシイミノー1-フェニルプロパン-1-オン等が挙げられる。

54

【0095】本発明において使用することができる好ましい増感剤(成分(iv))としては次のようなものが挙げられる。例えば、シアニン色素、メロシアニン色素、(ケト)クマリン色素、(チオ)キサンテン色素、アクリジン色素、チアゾール色素、チアジン色素、オキサジン色素、アジン色素、アミノケトン色素、スクアリリウム色素、ピリジニウム色素、(チア)ピリリウム色素、ポルフィリン色素、トリアリールメタン色素、(ポリ)メチン色素、アミノスチリル化合物及び芳香族多環式炭化水素である。このうち、好ましい増感剤は、シアニン色素、メロシアニン色素、(ケト)クマリン色素、(チオ)キサンテン色素、(ポリ)メチン色素、アミノスチリル化合物である。

【0096】シアニン色素の例としては、特開昭64-13140号公報に記載のものが挙げられる。メロシア ニン色素としては、特開昭59-89303号、特開平 2-244050号、特開平2-179643号各公報 記載のものが挙げられる。(ケト)クマリン色素の例と しては、Polymer. Eng. Sci. 23, 1022 (1983)、特 開昭63-178105号公報に記載のものが挙げられ る。(チオ)キサンテン色素の例としては、特開昭64 -13140号、特開平1-126302号公報に記載 のものが挙げられる。(ポリ)メチン色素の例として は、特願平3-152062号、同3-232037 号、同3-264494号明細書に記載のものが挙げら れる。アミノスチリル化合物の例としては、特開昭55 -50001号、特開平2-69号、特開平2-630 53号、特開平2-229802号公報に記載のものが 挙げられる。400m~1000mの光を吸収しかつ光 開始剤を分光増感し得る上記の化合物 (iv) は、単独も しくは組み合せて、本発明の光重合性感光性組成物の中 で好適に使用し得るが、より好ましくは400nm~75 Onmの範囲の光を吸収しかつ光開始剤を分光増感し得る 以下の化合物を使用する。シアニン色素としては次の一

55

般式に従うものが特に有用である。

[0097]

[(£31]

$$C=L_1-(L_2=L_3)$$
 $X=$
 $X=$
 $X=$
 $X=$
 $X=$

【0098】式中、Z1及びZ2はシアニン色素に通常用 いられるヘテロ環核、特にチアゾール核、チアゾリン 核、ベンゾチアゾール核、ナフトチアゾール核、オキサ ゾール核、オキサゾリン核、ベンゾオキサゾール核、ナ フトオキサゾール核、テトラソール核、ピリジン核、キ ノリン核、イミダゾリン核、イミダゾール核、ベンゾイ ミダゾール核、ナフトイミダゾール核、セレナゾリン 核、セレナゾール核、ベンゾセレナゾール核、ナフトセ レナゾール核又はインドレニン核などを完成するに必要 な原子群を表わす。これらの核は、メチル基などの低級 アルキル基、ハロゲン原子、フェニル基、ヒドロキシル 基、炭素数1~4のアルコキシ基、カルボキシル基、ア ルコキシカルボニル基、アルキルスルファモイル基、ア ルキルカルバモイル基、アセチル基、アセトキシ基、シ アノ基、トリクロロメチル基、トリフルオロメチル基、 ニトロ基などによって置換されていてもよい。 L1、 L2 及びL3はメチン基、置換メチン基を表わす。置換メチ ン基としては、メチル基、エチル基等の低級アルキル 基、フェニル基、置換フェニル基、メトキシ基、エトキ シ基、フェネチル基等のアラルキル基等によって置換さ れたメチン基などがある。

【0099】L₁とR₁、L₃とR₂及びm=3の時はL₂ とし2でアルキレン架橋し、5又は6員環を形成してよ い。R1とR2は低級アルキル基、(好ましくは炭素数が 1~8のアルキル基)、カルボキシ基、スルホ基、ヒド ロキシ基、ハロゲン原子、炭素数が1~4のアルコキシ 基、フェニル基、置換フェニル基等の置換を有するアル キル基(好ましくはアルキレン部分がC1~C5であ る)、例えば、 β -スルホエチル、 γ -スルホプロピ ル、 γ -スルホブチル、 δ - スルホブチル、2 - [(3) ースルホプロポキシ) エトキシ) エチル、2ーヒドロキ シスルホプロピル、2-クロロスルホプロピル、2-メ 40 トキシエチル、2-ヒドロキシエチル、カルボキシメチ ル、2-カルボキシエチル、2,2,3,3'ーテトラ フルオロプロピル、3,3,3-トリフルオロエチル; アリル基やその他の通常シアニン色素のNー置換基に用 いられている置換アルキル基を表わす。 mi は 1、2又 は3を表わす。X」はハロゲンイオンを表わす。

【0100】殊に好適なシアニン色素は次のものである。

[0101] [化32] S S S S Br - C7H15 Br - C7H15 Br - C7H15 C7H15

【0102】メロシアニン色素としては次の一般式に従うものが特に有用である。

[0103]

【化33】

$$\begin{array}{c|c}
R^4 & R^3 & R^2 \\
R^5 & R^6 & R^1
\end{array}$$

【0104】式中、R¹及びR²は各々独立して水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アルコキシ基、アルコキシカルボニル基、アリール基、置換アリール基又はアラルキル基を表す。R³、R⁴、R⁵及びR°は各々独立してR¹及びR²に挙げた基、もしくは、アルキルチオ基、アリールチオ基、アミノ基又は置換アミノ基を表す。Xは5~7員環を形成するのに必要な非金属原子群を表す。Zは置換又は無置換芳香環もしくは置換又は無置換へテロ芳香環を形成するのに必要な非金属原子群を表す。この中で特に好適なメロシアニン色素は次のものである。

[0105]

【化34】

【0106】また、次の一般式に従うメロシアニン色素も特に有用である。

[0107]

【化35】

【0108】式中、R¹及びR²は各々独立して水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アルコキシカルボニル基、アリール基、置換アリール基又はアラルキル基を表わす。Aは酸素原子、イオウ原子、セレン原子、テルル原子、アルキルないしはアリール置換された窒素原子、又はジアルキル置換された炭素原子を表わす。Xは含窒素へテロ5員環を形成するのに必要な非金属原子群を表わす。Yは置換フェニル基、無置換ないしは置換された多核芳香環、又は無置換ないしは置換されたのチロ芳香環を表わす。Zは水素原子、アルキル基、置換アルキル基、アリール基、置換アリール基、アラルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、置換アミノ基、アシル基、又はアルコキシカルボニル基を表わし、Yと互いに結合して環を形成してもよい。この中で特に好適なメロシアニン色素は次のものである。

[0109]

[化36]

[0110] 【化37】

$$\bigcirc \stackrel{(n)C_8H_{17}}{\underset{S}{\bigvee}} \stackrel{H}{\underset{O}{\bigvee}} -N(CH_3)_2$$

【0111】(ケト)クマリン色素としては次の一般式に従うものが特に有用である。

[0112]

【化38】

$$R_3 \xrightarrow{R_4} X \xrightarrow{R_5} R_6$$

【0113】式中、R1~R1は互いに独立して、水素原 子、ハロゲン原子、アルキル基、置換アルキル基、アリ ール基、置換アリール基、水酸基、アルコキシ基、置換 30 アルコキシ基、アミノ基、置換アミノ基を表す。またR 1~R4はそれが結合できる炭素原子と共に非金属原子か ら成る環を形成していても良い。Rs は水素原子、アル キル基、置換アルキル基、アリール基、置換アリール 基、ヘテロ芳香族基、置換ヘテロ芳香族基、シアノ基、 アルコキシ基、置換アルコキシ基、カルボキシ基、アル ケニル基、置換アルケニル基を表す。R6は、R7又は一 Z-R,であり、R,は上記R,の範囲のものから選択さ れる。Zはカルボニル基、スルホニル基、スルフィニル 基、又はアリーレンジカルボニル基を表す。Rs及びR。 40 は共に非金属原子から成る環を形成しても良い。 X は O、S、NH、又は置換基を有する窒素原子を表す。Y は、酸素原子、又は=CG₁G₂であり、G₁及びG₂は同 ーでも異なっていても良く、水素原子、シアノ基、アル コキシカルボニル基、置換アルコキシカルボニル基、ア リールオキシカルボニル基、置換アリールオキシカルボ ニル基、アシル基、置換アシル基、アリールカルボニル 基、置換アリールカルボニル基、アルキルチオ基、アリ ールチオ基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニ ル基、フルオロスルホニル基を表す。但し、G1とG2と 50 共に水素原子ではない。又G1及びG2はそれが形成でき

る炭素原子と共に非金属原子から成る環を形成していて も良い。この中で特に好適な(ケト)クマリン色素は次 のものである。

[0114] [化39]

$$H_5C_2$$
 H_5C_2
 CN
 CN

$$H_5C_2$$
 CH_3
 CN
 $CO_2C_2H_5$

【0115】キサンテン色素としては次の一般式に従う ものが特に有用である。

[0116]

$$R^{1}-N-(CH=CH) + C=(L^{1}=L^{2}) + C=(CH=CH) + R^{2}$$

$$(X)^{-m}$$

20

【0121】式中、 Z^1 及び Z^2 は各々シアニン色素で通常用いられる5員環又は6員環の含窒素複素環を形成するに必要な非金属原子群を表す。 R^1 及び R^2 は各々アルキル基を表わす。 Q^1 と Q^2 は組み合わせることにより、4- チアゾリジノン環、5- チアゾリジノン環、4- イーイミダゾリジノン環、4- オーオキサゾリジノン環、5- オー 40サゾリジノン環、5- イミダゾリジノン環又は4- ジチオラノン環を形成するに必要な原子群を表わす。 L^1 、

* [化 4 0]
R₁
R₂
N
O
R₄
X
O
C
C
O
N
R₄
X

60

【0117】式中、R1、R2、R3及びR4は各々独立に水素原子、炭素数1~6のアルキル基又はアリール基を 10 表わし、Xはハロゲンイオンを表わし、Yはアルキル 基、アリール基、水素原子又はアルカリ金属を表す。この中で特に好適なキサンテン色素は次のものである。

[0118]

【0119】 (ポリ) メチン色素としては次の一般式に 従うものが特に有用である。

【0120】 【化42】

 L^2 、 L^3 、 L^4 及び L^5 はそれぞれメチン基を表わす。mは1又は2を表わす。i及びhは各々0又は1を表わす。lは1又は2を表わす。j及びkは各々0、1、2又は3を表わす。 X^5 は、対アニオンを表わす。この中で特に好適な(ポリ)メチン色素は次のものである。

40 【0122】 【化43】

[0123]

【0124】アミノスチリル化合物としては次の一般式に従うものが特に有用である。

[0125]

【化45】

$$\begin{array}{c|c}
 & X \\
 & X \\$$

【0126】式中、環Aはベンゼン環又はナフタリン環を表わし、これらは置換基を有してもよい。Xは二価原子又は二価基を示す。 R^1 はアルキル基を表わし、 R^2 及び R^3 は水素、アルキル基、アルコキシ基又はアルキルチオ基を表わし、 R^1 と R^2 は相互に結合していてもよい。1は0、1又は2を表わす。この中で特に好適なアミノスチリル化合物は次のものである。

[0127] 【化46】

【0128】本発明において使用することができる成分(v)の(イ)群に属するものとしては、各種アミン類が挙げられ、具体例としては次のようなものである。

[0129]

【化47】

40

示されるチオ化合物の具体例としては、下表に示すよう * 【0134】 ${\rm kR}^4$ 及び ${\rm R}^5$ を有する化合物が挙げられる。但し、化合 【 ${\rm k}1$ 】

	<u>表 1</u>		
化合物No.	R ⁴	$ m R^5$	
1	-H	-H	
2	-H	-CH ₃	
3	-CH ₃	-H	
4	-CH ₃	-CH ₃	
5	-C ₆ H ₅	$-C_2H_5$	
6	$-C_6H_5$	$-C_4H_9$	
7	-C ₆ H ₄ Cl	-CH ₃	
8	-C ₆ H ₄ Cl	-C ₄ H ₉	
9	$-C_6H_4-CH_3$	C ₄ H ₉	
10	$-C_6H_4-OCH_3$	$-CH_3$	
11	$-C_6H_4-OCH_3$	$-C_2H_5$	
12	$-C_6H_4-OC_2H_5$	-CH ₃	
13	$-C_6H_4-OC_2H_5$	-C2H5	
14	$-C_6H_4-OCH_3$	-C4H9	
15	-(CH ₂) ₃ -		
16	$-(CH_2)_2-S-$		
17	-CH(CH ₃)-CH	(₂ -S-	
18	-CH2-CH(CH	3)-S-	
19	-C(CH ₃) ₂ -CH ₂	2 - S-	
20	-CH2-C(CH3)	2-S-	
21	-(CH ₂) ₂ -O-		
22	-CH(CH ₃)-CH		
23	$-C(CH_3)_2-CH_2$	2-0-	
24	-CH = CH - N(C)	H ₃)-	
25	$-(CH_2)_3-S-$		
26	-(CH ₂) ₂ CH(CH	3)-S-	
27	-(CH ₂) ₃ -0-		
28	-(CH ₂) ₅ -		
29	$-C_6H_4-O-$		
30	$-N = C(SCH_2) -$	8-	
31	$-C_6H_4-NH-$		
32	$-C_6H_4-NC_2H_5$, -	

化合物No.	\mathbf{R}^{4}		R^5
33		(1)	
34		(2)	
35		(3)	
36	((4)	
37	((5)	
38		(6)	
39		(7)	
40 .	((8)	
41	(9)	
42	(10)	
43	(11)	
44	(12)	
45	(13)	
46 .	(14)	

【0136】上記表1のR ⁴ 及びR ³ の式である。 【0137】	は、以上の通り		$C_{5}H_{11}-C-NH$ NH-	5)
【化51】		20	\Leftrightarrow	
CI CO	(1)		(n)C ₄ H ₉ -CH-C-NH NH- (6 C ₂ H ₅	6)
CH ₃ NH-	(2)		CI NH-	7)
CH ₃ NH-	(3)	30	NH- (8	3)
$0 \\ \begin{array}{c} C_5H_{11}-C-NH \\ O \\ NH-C \\ \end{array}$	(4)		【0139】 【化53】	

【0138】 【化52】

$$C_2H_5$$
 N
 C_2H_5
 N
 C_2H_5
 N
 N

$$\begin{array}{c|c}
C_5H_{11}-C-NH & & & \\
0 & & & \\
\end{array}$$

【0140】成分(v)の(ハ)群に属する化合物の具 体例としては、特開平2-179643号公報に記載の ものが挙げられる。本発明において使用することができ る光開始剤(成分(iii))の含有濃度は通常わずかな ものである。また、不適当に多い場合には有効光線の遮 断等好ましくない結果を生じる。本発明における光開始 剤の量は、重合可能な化合物(成分(i))と線状有機 高分子重合体(成分(ii))との合計に対して一般に 0.01~60%、好ましくは、1~30%である。光 開始剤(成分(iii))と増感剤(成分(iv))の割合 は、増感剤(成分(iv))1重量部に対して、一般に光 開始剤(成分(iii))を0.05~30重量部、好ま しくは0.1~10重量部、更に好ましくは0.2~5 重量部である。成分(v)を加える場合、添加量は、光 開始剤(成分(iii)) 1 重量部に対して一般に 0.0 5~50重量部、好ましくは0.1~30重量部、更に 好ましくは0.2~10重量部である。

【0141】本発明で使用する光重合性感光性組成物には、以上の基本成分の他に、感光性組成物の製造中あるいは保存中において重合可能な化合物(成分(i))の不要な熱重合を阻止するために少量の熱重合防止剤を添加することが望ましい。適当な熱重合防止剤としてはハイドロキノン、p-メトキシフェノール、ジーt-ブチルーp-クレゾール、ピロガロール、t-ブチルカテコール、ベンゾキノン、4,4'ーチオビス(3-メチルー6ーt-ブチルフェノール)、N-ニトロソフェニルヒドロキシルアミンアルミニウム塩などが挙げられる。熱重合防止剤の添加量は、全組成物の重量に対して一般に0.01~10%、好ましくは0.01~5%である。必要に応じて、酸素による重合50

阻害を防止するためにベヘン酸やベヘン酸アミドのような高級脂肪酸誘導体等を添加して、塗布後の乾燥の過程で感光層の表面に偏在させてもよい。高級脂肪酸誘導体の添加量は、全組成物重量に対して、一般に0.1~約20%、好ましくは0.5~10%である。更に、感光層の着色を目的として染料もしくは顔料を添加してもよい。染料及び顔料の添加量は全組成物の重量に対して一般に0.1~10%、好ましくは0.5~5%である。加えて、硬化皮膜の物性を改良するために無機充填剤10 や、その他の公知の添加剤を加えてもよい。

【0142】本発明の光重合性組成物を支持体上に塗布 する際には種々の有機溶剤に溶かして使用に供される。 ここで使用する溶媒としては、アセトン、メチルエチル ケトン、シクロヘキサン、酢酸エチル、エチレンジクロ ライド、テトラヒドロフラン、トルエン、エチレングリ コールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエ チルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、 プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレン グリコールモノエチルエーテル、アセチルアセトン、シ クロヘキサノン、ジアセトンアルコール、エチレングリ コールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコ ールエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモ ノイソプロピルエーテル、エチレングリコールモノブチ ルエーテルアセテート、3-メトキシプロパノール、メ トキシメトキシエタノール、ジエチレングリコールモノ メチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエー テル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチ レングリコールジエチルエーテル、プロピレングリコー ルモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコー ルモノエチルエーテルアセテート、3-メトキシプロピ ルアセテート、N, N-ジメチルホルムアミド、ジメチ ルスルホキシド、yーブチロラクトン、乳酸メチル、乳 酸エチルなどがある。これらの溶媒は、単独あるいは混 合して使用することができる。そして、塗布溶液中の固 形分の濃度は、一般に2~50%、好ましくは5~30 %である。その被覆量は乾燥後の重量で0.1~10g $/m^2$ である、好ましくは $0.5\sim 5$ g $/m^2$ である。

【0143】(B) コンベンショナルポジ感光層

また、表面処理層を設け、かつ親水性表面を有するアルミニウム板上に、公知の感光性組成物よりなる感光層を設けて、感光性平版印刷版を得ることもできる。感光性組成物としては、oーキノンジアジド化合物を主成分とするポジ型、ジアゾニウム塩、アルカリ可溶性ジアゾニウム塩、不飽和二重結合含有モノマーを主成分とする光重合性化合物および桂皮酸やジメチルマレイミド基を含む光架橋性化合物などを感光物とするネガ型のものが用いられる。

【0144】このうちポジ型の感光性組成物として用いられるoーナフトキノンジアジド化合物としては、特公昭43-28403号公報に記載されている1,2-ジ

アゾナフトキノンスルホン酸とピロガロール・アセトン 樹脂とのエステルが好ましい。その他の好適なオルトキ ノンジアジド化合物としては例えば、米国特許第3,0 46,120号および同第3,188,210号明細書 に記載されている1,2-ジアゾナフトキノン-5-ス ルホン酸とフェノールーホルムアルデヒド樹脂とのエス テルがあり、特開平2-96163号公報、特開平2-96165号公報および特開平2-96761号公報に 記載されている1, 2-ジアゾナフトキノンー4-スル ホン酸とフェノールーホルムアルデヒド樹脂とのエステ ルがある。その他の有用なoーナフトキノンジアジド化 合物としては、数多くの特許等で公知のものが挙げられ る。例えば、特開昭47-5303号、同48-638 02号、同48-63803号、同48-96575 号、同49-38701号、同48-13854号、特 公昭37-18015号、同41-11222号、同4 5-9610号、同49-17481号公報、米国特許 第2,797,213号、同第3,454,400号、 同第3.544,323号、同第3,573.917 号、同第3,674,495号、同第3,785,82 5号、英国特許第1, 227, 602号、同第1, 25 1, 345号、同第1, 267, 005号、同第1, 3 29.888号、同第1,330,932号、ドイツ特 許第854、890号などの各明細書中に記載されてい るものを挙げることができる。

【0145】本発明において特に好ましい、0ーナフト キノンジアジド化合物は、分子量1,000以下のポリ ヒドロキシ化合物と1,2-ジアゾナフトキノンスルホ ン酸との反応により得られる化合物である。このような 化合物の具体例は、特開昭51-139402号、同5 8-150948号、同58-203434号、同59 -165053号、同60-121445号、同60-134235号、同60-163043号、同61-1 18744号、同62-10645号、同62-106 46号、同62-153950号、同62-17856 2号、同64-76047号、米国特許第3, 102, 809号、同第3, 126, 281号、同第3, 13 0,047号、同第3,148,983号、同第3,1 84,310号、同第3,188,210号、同第4, 639、406号などの各公報または明細書に記載され 40 ているものを挙げることができる。

【0146】 これらのo-ナフトキノンジアジド化合物を合成する際は、ポリヒドロキシ化合物のヒドロキシル基に対して1, 2-ジアゾナフトキノンスルホン酸クロリドを<math>0. $2\sim1$. 2当量反応させることが好ましく、0. $3\sim1$. 0当量反応させることが更に好ましい。1, 2-ジアゾナフトキノンスルホン酸クロリドとしては、<math>1, 2-ジアゾナフトキノン-5-スルホン酸クロリドまたは、<math>1, 2-ジアゾナフトキノン-4-スルホン酸クロリドを用いることができる。また、得られる<math>o 50

ーナフトキノンジアジド化合物は、1,2ージアゾナフトキノンスルホン酸エステル基の位置および導入量の種々異なるものの混合物となるがヒドロキシル基の全てが1,2ージアゾナフトキノンスルホン酸エステル化された化合物が、この混合物中に占める割合(完全にエステル化された化合物の含有率)は5モル%以上であることが好ましく、更に好ましくは $20\sim99$ モル%である。本発明の感光性組成物中に占めるこれらのポジ型に作用する感光性化合物(上記のような組合せを含む)の量は $10\sim50$ 重量%が適当であり、より好ましくは $15\sim40$ 重量%である。

【0147】o-キノンジアジド化合物は単独でも感光 層を構成することができるが、アルカリ水に可溶な樹脂 を結合剤(バインダー)として併用することが好まし い。この様なアルカリ水に可溶な樹脂としては、ノボラ ック型の樹脂があり、例えばフェノールホルムアルデヒ ド樹脂、oー、mーおよびpークレゾールホルムアルデ ヒド樹脂、m/p-混合クレゾールホルムアルデヒド樹 脂、フェノール/クレゾール(oー、mー、pー、m/ p-およびo/m-混合のいずれでもよい)混合ホルム アルデヒド樹脂などが挙げられる。また、フェノール変 性キシレン樹脂、ポリヒドロキシスチレン、ポリハロゲ ン化ヒドロキシスチレン、特開昭51-34711号公 報に開示されているようなフェノール性水酸基を含有す るアクリル系樹脂も用いることができる。その他の好適 なバインダーとして、バックコート層に添加する高分子 化合物を形成するモノマーの例として挙げた前記(1) ~ (12) に示すモノマー、及び(13) アクリル酸、 メタクリル酸、無水マレイン酸、イタコン酸などの不飽 和カルボン酸をその構成単位とする通常1万~20万の 分子量を持つ共重合体を挙げることができる。

【0148】更に、上記モノマーと共重合し得るモノマ ーを共重合させてもよい。また、上記モノマーの共重合 によって得られる共重合体を例えば、グリシジルアクリ レート、グリシジルメタクリレートなどによって修飾し たものも含まれるがこれらに限られるものではない。上 記共重合体には、(13)に掲げたアクリル酸、メタク リル酸、無水マレイン酸、イタコン酸等の不飽和カルボ ン酸を含有することが好ましく、その共重合体の好まし い酸価は $0\sim10\text{meq/g}$ 、より好ましくは $0.2\sim5$. Omeq/gである。上記共重合体の好ましい分子量は1万 ~10万である。また、上記共重合体には必要に応じ て、ポリビニルブチラール樹脂、ポリウレタン樹脂、ポ リアミド樹脂およびエポキシ樹脂を添加してもよい。こ のようなアルカリ可溶性の高分子化合物は1種類あるい は2種類以上組み合わせることができ、全感光性組成物 の80重量%以下の添加量で用いられる。更に、米国特 許第4,123,279号明細書に記載されているよう に、tーブチルフェノールホルムアルデヒド樹脂、オク チルフェノールホルムアルデヒド樹脂のような炭素数3

~8のアルキル基を置換基として有するフェノールとホルムアルデヒドとの縮合物を併用することは画像の感脂性を向上させる上で好ましい。

73

【0149】本発明における感光性組成物中には、感度 を高めるために環状酸無水物類、フェノール類、有機酸 類を添加することが好ましい。環状酸無水物としては米 国特許第4,115,128号明細書に記載されている 無水フタル酸、テトラヒドロ無水フタル酸、ヘキサヒド ロ無水フタル酸、3, 6-エントオキシーΔ¹-テトラ ヒドロ無水フタル酸、テトラクロル無水フタル酸、無水 マレイン酸、クロル無水マレイン酸、α-フェニル無水 マレイン酸、無水コハク酸、無水ピロメリット酸などが 使用できる。フェノール類としては、ビスフェノール A、pーニトロフェノール、pーエトキシフェノール、 2. 4. 4'ートリヒドロキシベンゾフェノン、2. 3, 4ートリヒドロキシベンゾフェノン、4ーヒドロキ シベンゾフェノン、4,4',4"-トリヒドロキシー トリフェニルメタン、4,4',3",4"ーテトラヒ ドロキシー3, 5, 3', 5'ーテトラメチルトリフェ ニルメタンなどが挙げられる。更に、有機酸類として は、特開昭60-88942号、特開平2-96755 号公報などに記載されいてる、スルホン酸類、スルフィ ン酸類、アルキル硫酸類、ホスホン酸類、リン酸エステ ル類およびカルボン酸類などがあり、具体的には、p-トルエンスルホン酸、ドデシルベンゼンスルホン酸、p ートルエンスルフィン酸、エチル硫酸、フェニルホスホ ン酸、フェニルホスフィン酸、リン酸フェニル、リン酸 ジフェニル、安息香酸、イソフタル酸、アジピン酸、p ートルイル酸、3, 4ージメトキシ安息香酸、フタル 酸、テレフタル酸、1,4-シクロヘキセン-2,2-ジカルボン酸、エルカ酸、ラウリン酸、n-ウンデカン 酸、アスコルビン酸などが挙げられる。上記の環状酸無 水物類、フェノール類および有機酸類の感光性組成物中 に占める割合は、0.05~15重量%が好ましく、よ り好ましくは $0.1 \sim 5$ 重量%である。

【0150】また、本発明における感光性組成物中には、現像条件に対する処理の安定性(いわゆる現像ラチチュード)を広げるため、特開昭62-251740号公報や特開平2-96760号、同4-68355号公報に記載されているような非イオン界面活性剤、特開昭4059-121044号公報、特開平4-13149号公報に記載されているような両性界面活性剤を添加することができる。非イオン界面活性剤の具体例としては、ソルビタントリステアレート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタントリオレート、ステアリン酸モノゲリセリド、ポリオキシエチレンソルビタンモノオレート、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテルなどが挙げられる。両性界面活性剤の具体例としては、アルキルジ(アミノエチル)グリシン、アルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩、2-アルキルーN-カルボキシエチル50

-N-ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタインやN-アトラデシル-N, N-ベタイン型(例えば、商品名アモーゲンK、第一工業(株)製)およびアルキルイミダゾリン系(例えば、商品名レボン15、三洋化成(株)製)などが挙げられる。上記非イオン界面活性剤および両性界面活性剤の感光性組成物中に占める割合は、0.05-15重量%が好ましく、より好ましくは0.1-5重量%である。

【0151】本発明における感光性組成物中には、露光 後直ちに可視像を得るための焼き出し剤や、画像着色剤 としての染料や顔料を加えることができる。焼き出し剤 としては、露光によって酸を放出する化合物(光酸放出 剤)と塩を形成し得る有機染料の組合せを代表として挙 げることができる。具体的には、特開昭50-3620 9号、同53-8128号の各公報に記載されているo ーナフトキノンジアジドー4-スルホン酸ハロゲニドと 塩形成性有機染料の組合せや、特開昭53-36223 号、同54-74728号、同60-3626号、同6 1-143748号、同61-151644号および同 63-58440号の各公報に記載されているトリハロ メチル化合物と塩形成性有機染料の組合せを挙げること ができる。かかるトリハロメチル化合物としては、オキ サゾール系化合物とトリアジン系化合物とがあり、どち らも経時安定性に優れ、明瞭な焼き出し画像を与える。 画像の着色剤としては前述の塩形成性有機染料以外に他 の染料を用いることができる。塩形成性有機染料も含め て、好適な染料として油溶性染料と塩基性染料を挙げる ことができる。具体的にはオイルイエロー#101、オ イルイエロー#103、オイルピンク#312、オイル グリーンBG、オイルブルーBOS、オイルブルー#6 03、オイルブラックBY、オイルブラックBS、オイ ルブラックT-505(以上、オリエント化学工業 (株) 製)、ビクトリアピュアブルー、クリスタルバイ オレット(CI42555)、メチルバイオレット(C I42535)、エチルバイオレット、ローダミンB (CI145170B)、マラカイトグリーン(CI4 2000)、メチレンブルー(CI52015)などを 挙げることができる。また、特開昭62-293247 号公報に記載されている染料は特に好ましい。

【0152】本発明における感光性組成物は、上記各成分を溶解する溶媒に溶かして支持体のアルミニウム板上に塗布される。ここで使用される溶媒としては、特開昭62-251739号公報に記載されているような有機溶剤が単独あるいは混合して用いられる。本発明の感光性組成物は、2~50重量%の固形分濃度で溶解、分散され、支持体上に塗布・乾燥される。支持体上に塗設される感光性組成物の層(感光層)の塗布量は用途により異なるが、一般的には、乾燥後の重量にして0.3~4.0g/m²が好ましい。塗布量が小さくなるにつれて画像を得るための露光量は小さくて済むが、膜強度は低

下する。塗布量が大きくなるにつれ、露光量を必要とするが感光膜は強くなり、例えば、印刷版として用いた場合、印刷可能枚数の高い(高耐刷の)印刷版が得られる。本発明における感光性組成物中には、塗布面質を向上するための界面活性剤、例えば、特開昭 62-170 950号公報に記載されているようなフッ素系界面活性剤を添加することができる。好ましい添加量は、全感光性組成物の0.001~1.0重量%であり、更に好ましくは0.005~0.5重量%である。

【0153】(C) コンベンショナルネガ感光層 次に、本発明の表面処理層が適用されるネガ型のPS版 の感光性組成物としては、感光性ジアゾ化合物を含む感 光層、光重合性感光層、光架橋性感光層などを有するも のが挙げられるが、このうち感光性ジアゾ化合物からな る光硬化性感光性複写材料について例を挙げて詳しく説 明する。本発明のPS版に用いられる感光性ジアゾ化合 物としては、芳香族ジアゾニウム塩と反応性カルボニル 基含有有機縮合剤、特にホルムアルデヒド、アセトアル デヒドなどのアルデヒド類またはアセタール類とを酸性 媒体中で縮合したジアゾ樹脂が好適に用いられる。その 最も代表的なものに p ージアゾフェニルアミンとホルム アルデヒドとの縮合物がある。これらのジアゾ樹脂の合 成法は、例えば、米国特許第2,679,498号、同 第3,050,502号、同第3,311,605号お よび同第3,277,074号の明細書に記載されてい る。更に、感光性シアゾ化合物としては、特公昭49-48001号公報記載の芳香族ジアゾニウム塩とジアゾ ニウム基を含まない置換芳香族化合物との共縮合ジアゾ 化合物が好適に用いられ、中でもカルボキシル基や水酸 基のようなアルカリ可溶基で置換された芳香族化合物と の共縮合ジアゾ化合物が好ましい。更には、特開平4-18559号公報、特願昭2-321823号および同 2-299551号明細書記載のアルカリ可溶性基を持 つ反応性カルボニル化合物で芳香族ジアゾニウム塩を縮 合した感光性ジアゾ化合物も好適に用いられる。

【0154】これらのジアゾニウム塩の対アニオンとして塩酸、臭化水素酸、硫酸およびリン酸などの鉱酸または塩化亜鉛との複塩などの無機アニオンを用いたジアゾ樹脂があるが、実質的に水不溶性で有機溶剤可溶性のジアゾ樹脂の方が特に好ましい。かかる好ましいジアゾ樹脂は特公昭47-1167号、米国特許第3,300,309号公報に詳しく記載されている。更には特開昭54-98613号、同56-121031号公報に記載されているようなテトラフルオロホウ酸、ヘキサフルオロリン酸などのハロゲン化ルイス酸および過塩素酸、過ヨウ素酸などの過ハロゲン酸を対アニオンとしたジアゾ樹脂が好適に用いられる。また、特開昭58-209733号、同62-175731号、同63-262643号公報に記載されている長鎖のアルキル基を有するスルホン酸を対アニオンとしたジアゾ樹脂も好適に用いら50

れる。感光性ジアゾ化合物は感光層中に $5\sim5$ 0 重量%、好ましくは $8\sim2$ 0 重量%の範囲で含有させられる。

【0155】本発明で用いられる感光性ジアゾ化合物 は、アルカリ水に可溶性もしくは膨潤性の親油性高分子 化合物を結合剤(バインダー)として併用することが好 ましい。この様な親油性高分子化合物としては、先に述 べたポジ型感光性組成物で用いたのと同様の前記(1) ~ (13) に示すモノマーをその構成単位とする通常1 10 万~20万の分子量を持つ共重合体を挙げることができ るが、更に以下(14)、(15)に示すモノマーを構 成単位として共重合した高分子化合物も使用できる。 (14) マレイミド、N-アクリロイルアクリルアミ ド、N-アセチルアクリルアミド、N-プロピオニルア **クリルアミド、N-(p-クロロベンゾイル)アクリル** アミド、Nーアセチルアクリルアミド、Nーアクリロイ ルメタクリルアミド、N-アセチルメタクリルアミド、 N-プロピオニルメタクリルアミド、N-(p-クロロ ベンゾイル)メタクリルアミドなどの不飽和イミド、 (15) N- [6-(アクリロイルオキシ) - ヘキシ ル] -2. 3-ジメチルマレイミド、N- [2-(メタ クリロイルオキシ) -ヘキシル] -2, 3-ジメチルマ レイミド、ビニルシンナメートなどの側鎖に架橋性基を 有する不飽和モノマー。更に、上記モノマーと共重合し 得るモノマーを共重合させてもよい。また、上記モノマ 一の共重合によって得られる共重合体を例えば、グリシ ジルアクリレート、グリシジルメタクリレートなどによ って修飾したものも含まれるがこれらに限られるもので はない。上記共重合体には(13)に掲げた不飽和カル ボン酸を含有することが好ましく、その共重合体の好ま しい酸価は $0\sim10\text{meq/g}$ 、より好ましくは $0.2\sim$ 5. Omeq/gである。

【0156】上記共重合体の好ましい分子量は1万~10万である。また、上記共重合体には必要に応じて、ポリビニルブチラール樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリアミド樹脂およびエポキシ樹脂を添加してもよい。また、ノボラック型の樹脂、フェノール変性キシレン樹脂、ポリヒドロキシスチレン、ポリハロゲン化ヒドロキシスチレン、特開昭51-34711号公報に開示されているようなフェノール性水酸基を含有するアルカリ可溶性の高分子化合物は1種類あるいは2種類以上組み合わせることができ、全感光性組成物の固形分中に通常40~95重量%の範囲で含有させられる。

【0157】本発明における感光性組成物中には、画像の感脂性を向上させるための感脂化剤(例えば、特開昭55-527号公報記載のスチレンーマレイン酸共重合体のアルコールによるハーフエステル化物、ノボラック樹脂、pーヒドロキシスチレンの50%脂肪酸エステルなど)が加えられる。更には、塗膜の柔軟性、耐摩耗性

を付与するための可塑剤が加えられる、例えば、ブチルフタリル、ポリエチレングリコール、クエン酸トリブチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジオクチル、リン酸トリクレジル、リン酸トリブチル、リン酸トリオクチル、オレイン酸・リン酸トリブチル、リン酸トリオクチル、オレイン酸・トラヒドロフルフリル、アクリル酸またはメタアクリル酸のオリゴマーおよびポリマーが挙げられ、この中で特にリン酸トリクレジルが好ましい。また、本発明における感光性組成物中には、経時の安定性を広げるため、ジピコリンを感、インゼンスルホン酸、オフタレンスルホン酸、スルホリチル酸、4ーメトキシー2ーヒドロキシベンゾフェノン-5ースルホン酸、酒石酸などが加えられる。

【0158】また、本発明における感光性組成物中に は、露光後直ちに可視像を得るための焼き出し剤や、画 像着色剤としての染料や顔料などの色素を加えることが できる。該色素としては、フリーラジカルまたは酸と反 応して色調を変えるものが好ましく用いられる。例え ば、ビクトリアピュアブルーBOH(保土谷化学製)、 オイルイエロー#101、オイルイエロー#103、オ イルピンク#312、オイルレッド、オイルグリーンB G、オイルブルーBOS、オイルブルー#603、オイ ルブラックBY、オイルブラックBS、オイルブラック T-505(以上、オリエント化学工業(株)製)、パ テントピュアブルー(住友三国化学社製)、クリスタル バイオレット(CI42555)、メチルバイオレット (CI42535)、エチルバイオレット、ローダミン B (CI145170B)、マラカイトグリーン (CI 42000)、メチレンブルー(CI52015)、ブ リリアントブルー、メチルグリーン、エリスリシンB、 ベーシックフクシン、m-クレゾールパープル、オーラ ミン、4-p-ジエチルアミノフェニルイミナフトキノ ン、シアノーpージエチルアミノフェニルアセトアニリ ドなどに代表されるトリフェニルメタン系、ジフェニル メタン系、オキサジン系、キサンテン系、イミノナフト キノン系、アゾメチン系またはアントラキノン系の色素 が有色から無色あるいは異なる有色の色調へ変化する例 として挙げられる。

【0159】一方、無色から有色に変化する変色剤としては、ロイコ色素および、例えば、トリフェニルアミ 40 ン、ジフェニルアミン、o-クロロアニリン、1, 2, 3-トリフェニルグアニジン、ナフチルアミン、ジアミノジフェニルメタン、p, p'-ビスージメチルアミノジフェニルアミン、1, 2-ジアニリノエチレン、p, p', p''-トリスージメチルアミノトリフェニルメタン、p, p'-ビスージメチルアミノジフェニルメチルイミン、p, p'-ビスージメチルアミノジフェニルメタン、p, p'-ビスージメチルアミノジフェニルメタン、p, p'-ビスージメチルアミノジフェニルー4ーアニリノナフチルメタン、p, p', p''ートリアミノトリフェニルメタンに代表される第1級ま 50

たは第2級アリールアミン系色素が挙げられる。特に好ましくはトリフェニルメタン系、ジフェニルメタン系色素であり、更に好ましくはトリフェニルメタン系色素であり、特にビクトリアピュアブルーBOHである。上記色素は、感光性組成物中に通常約 $0.5\sim10$ 重量%、より好ましくは約 $1\sim5$ 重量%含有される。

【0160】本発明における感光性組成物中には、現像 性を高めるために環状酸無水物類、フェノール類、有機 酸類および高級アルコールを添加することができる。本 発明における感光性組成物は、上記各成分を溶解する溶 媒に溶かして支持体のアルミニウム板上に塗布される。 ここで使用される溶媒としては、特開昭62-2517 39号公報に記載されているような有機溶剤が単独ある いは混合して用いられる。本発明の感光性組成物は、2 ~50重量%の固形分濃度で溶解、分散され、支持体上 に塗布・乾燥される。支持体上に塗設される感光性組成 物の層 (感光層) の塗布量は用途により異なるが、一般 的には、乾燥後の重量にして $0.3 \sim 4.0 \text{ g/m}^2$ が好 ましい。塗布量が小さくなるにつれて画像を得るための 露光量は小さくて済むが、膜強度は低下する。塗布量が 大きくなるにつれ、露光量を必要とするが感光膜は強く なり、例えば、印刷版として用いた場合、印刷可能枚数 の高い(高耐刷の)印刷版が得られる。本発明における 感光性組成物中には、先に示したポジ型感光性組成物と 同様に、塗布面質を向上するための界面活性剤を添加す ることができる。本発明の感光性印刷版の製造に当たっ ては裏面のバックコート層と表面の感光性組成物層のど ちらが先に支持体上に塗布されても良く、また両者が同 時に塗布されても良い。

【0161】本発明において、一般式(I)で表される 化合物から出発する組成物との組み合わせに好適に使用できるのが上記の(A)光重合性化合物、(B)コンベンショナルポジ感光層、及び(C)コンベンショナルネガ感光層であり、一般式(II)で表される化合物から出発する組成物との組み合わせに好適に使用できるのが上記の(A)光重合性化合物である。

[0162]

【実施例】以下、本発明について実施例により更に詳細 に説明するが、本発明の範囲はこれらの実施例によって 限定されるものではない。

【0163】実施例1

厚さ0.30mmのアルミニウム板をナイロンブラシと400メッシュのパミストンの水懸濁液とを用いその表面を砂目立てした後、よく水で洗浄した。10%水酸化ナトリウムに70℃で60秒間浸漬してエッチングした後、流水で水洗後20%硝酸で中和洗浄し、次いで水洗した。この基板を、 $V_A=12.7$ Vの条件下で正弦波の交番波形電流を用いて1%硝酸水溶液中で160クーロン/ d_m^2 の陽極時電気量で電解粗面化処理を行った。その表面粗さを測定したところ、0.6 μ (R_a 表示)で

あった。引き続いて30%の硫酸水溶液中に浸漬し、55℃で2分間デスマットした後、20%硫酸水溶液中、電流密度2A/dm²において陽極酸化皮膜の厚さが2.7g/m²になるように2分間陽極酸化処理した(この段階まで処理したアルミニウム板を以下AD基板と呼ぶ)。更に、3号ケイ酸ソーダの2.5重量%の水溶液を70℃に加熱した浴にAD基板を14秒間浸し、続いて水洗風乾した基板を用意した(以下、この基板をSI基板と呼ぶ)。

【0164】次に、下記の手順によりSG法の液状組成 10物 (ゾル液A1)を調製した。フェニルホスホン酸 0.24重量部を、メタノール130重量部、水20重量部、85%リン酸16部からなる混合液に溶解し、この溶液をテトラエチルシリケート50重量部および3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン48重量部の混合物と混合し、攪拌した。約5分で発熱が認められた。60分間反応させた後、内容物を別の容器へ移し、*

* メタノールを3000重量部加えることにより、ストック可能なゾル液 A1を得た。

【0165】こうして得られたゾル液A1は、ポリビンなどに移して封をして保存しておくと、3ヶ月経っても固形化することがなく、また沈澱も生じないが、上述の手順のうちメタノール3000重量部の添加を怠ると3ヶ月後には固形分の析出がおこった。次に、AD基板またはSI基板とゾル液A1を用いて、以下の手順でレーザ光感光性PS版を調製した。ゾル液A1をメタノール/エチレングリコール混合液(重量比9/1)で希釈して、基板上のSiの量が3mg/m²となるようにしてホイラーで塗布し、100℃で1分乾燥した。

【0166】このように処理された基板上に、下記組成の高感度光重合性組成物1を乾燥塗布重量が1.4g/m²となるように塗布し、80℃で2分間乾燥させ、感光層を形成した。

[0167]

光重合性組成物 1

トリメチロールプロパントリ(アクリロイルオキシプロピル)

エーテル	2. 0 g
線状有機高分子重合体 (B ₁)	2. 0 g
増感剤 (C ₁)	0. 13g
$(\lambda_{\text{max}} 472 \text{nm} (\varepsilon = 7. 4 \times 10^4))$	
光開始剤 (D ₁)	0.09g
チオ化合物(E1)	0.08g
フッ素系ノニオン界面活性剤	0.03g
メチルエチルケトン	2 0 g
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート	2 0 g
※ ※【化54】	-

[0168]

(B₁)

CH₃

CH₃

CH₂

C

(C₁)

$$(D_1) \qquad (E_1) \qquad \qquad H \qquad H \qquad H \qquad H \qquad H \qquad \qquad H \qquad$$

【0169】この感光層上にポリビニルアルコール(ケ ン化度86.5~89モル%、重合度1000)の3重 量%の水溶液を乾燥塗布重量が2g/m²となるように塗 布し、100℃で2分間乾燥させ、本発明に従う感光性 平版印刷版を得た。フェニルホスホン酸を添加しないこ と以外はゾル液A1と全く同様にしてゾル液H1を調製 し、AD基板またはSI基板とゾル液H1を用いて、全 く同様にして比較用の感光性平版印刷版を得た。本発明 に従う感光性平版印刷版および比較用の感光性平版印刷 版の感光性試験を、波長488nmの可視光により、以下 のように行なった。200mWの空冷アルゴンレーザーを 搭載したオプトロニクス社の高精細レーザープロッター により、4000dpi条件で0.1mJ/cm2の露光を行な った。更に、膜硬化度を高める目的で露光後110℃で 12秒の加熱処理を加えた。現像は、富士写真フイルム (株) 製DP-4現像液を水で18倍に希釈した液を用 いて、同社製850NX自動現像機により30℃、15

81

【0170】次に、これらの平版印刷版の耐刷性測定を行なった。印刷機はハイデルベルグ社製SOR-KZを、湿し水は富士写真フイルム(株)製EU-3(1:100)にイソプロパノールを10%添加したものを、インキとしては、大日本インキ社製クラフG(N)を使*

秒浸漬して行なった。

*用した。また、あわせて、非画像部の地汚れ、ブランケ ットの汚れ等を目視で評価した。評価結果を以下の表に 示す。ここで、ベタ耐刷性とは、ベタ印刷部に素抜け等 がおこることなく正常に印刷できる極限の印刷枚数をさ し、ハイライト耐刷性とは175線の2%の網点が印刷 物上で再現する極限の印刷枚数をさすものとするが、こ こでは、富士写真フイルム (株) 社製のPS版FNSA を100とした相対評価の形で示した。即ち、FNSA を同社製 P S ライトにて 1 mの距離から 1 分間ネガフィ ルムを用いて画像露光し、同社製水性アルカリ現像液D N-3Cを水道水で容積比1:1に希釈した液と、同社 製ガム液 F N-2を水道水で容積比1:1に希釈した液 を用いて、同社製自動現像機PS-800Hにて現像処 理した後、同じ印刷機にかけて耐刷力を印刷可能枚数と して求め、これを100とし、本発明に従う印刷版およ び比較用の印刷版の耐刷性を相対値で表わした。表中、 ○はこの相対値がFNSAと同等(100±5)である ことを意味し、◎はFNSA以上であることを表わす。 また、非画像部の地汚れ、ブランケットの汚れは、FN SAと同等のものを○、劣るものを×で表わした。

【0171】 【表3】

	基板	ゾル液	感光性組成物	ベタ 耐刷性	ハイライト 耐刷性	非画像部 の地汚れ	ブラン ケット の汚れ
実施例1	AD	ゾル被A1	光重合性組成物1	0	0	0	0
•	SI	"	•	0	0	0	_ 0_
比较例1	AD	ゾル液H1	,	0	0	×	×
	SI	•	*	0	0	×	×

【0172】本発明に従って有機リン酸系化合物を混ぜこんだゾル液で基板処理した感光性平版印刷版は、ベタ耐刷性、ハイライト耐刷性に何ら性能劣化をおこすことなく、非画像部の地汚れのおこりにくさ、ブランケット汚れのおこりにくさの点で、比較用の平版印刷版の性能※

※を凌いでいる。

【0173】実施例2

実施例 1 と同様にして、以下の原材料を混合することによりゾル液 A 2 、K 2 、I 2 、P 2 、N 2 および T 2 を調製した。

M. C. P. D. M. T. P. D. C. P.	
ゾル液 A 2	
フェニルホスホン酸	0.24重量部
メタノール	130重量部
水	3 4 重量部
硫酸	12重量部
Si (OC2 Hs)4	50重量部
3 – メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン	48重量部
ゾル液 K 2	
カテコール	0.16重量部
メタノール	130重量部
水	3 4 重量部
硫酸	12重量部
Si (OC2 H5)4	50重量部
3 – メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン	48重量部

83 ゾル液 I 2

PO₃H₂

[0174] 【化55】

* [0175]

0.81重量部

メタノール	130重量部
水	3 4 重量部
硫酸	12重量部
Si (OC2 H5)4	50重量部
3 – メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン	48重量部

3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン ゾル液P2

0.18重量部 ピロガロール メタノール 130重量部 3 4 重量部 水 12重量部 硫酸 50重量部 Si(OC₂ H₅)₄

3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン

ゾル液N2 2, 3-ジヒドロキシナフタレン 0.24重量部

メタノール 130重量部 3 4 重量部 水 12重量部 硫酸 Si (OC2 H5)4 50重量部

3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン 48重量部

[0176]

ゾル液T2

0.34重量部 2. 3. 4ートリヒドロキシベンゾフェノン メタノール 130重量部 3 4 重量部 水 硫酸 12重量部 Si (OC2 H5)4 50重量部 3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン 48重量部

【O177】次に、AD基板をこれらのゾル液で実施例 1と同様に処理し、光重合性組成物1およびポリビニル アルコールを実施例1と同様に塗布して感光性平版印刷 版を得た。また、分子量1000以下のフェノール類ま たは有機リン酸系化合物を添加しないこと以外はゾル液 A2~T2と全く同様にしてゾル液H2を調製し、AD※ ※ 基板をゾル液H2で同様に処理し、さらに光重合性組成 物1およびポリビニルアルコールを同様に塗布して、比 較用の感光性平版印刷版を得た。実施例1と同様の性能 評価を行なった結果を下表4に示す。

48重量部

[0178]

【表4】

	基板	ソル液	感光性組成物	ベタ 耐刷性	ハイライト 耐刷性	非画像部 の地汚れ	ブラン ケット の汚れ
実施例2	AD	ゾル液A2	光重合性組成物1	0	0	0	0
	*	ソル液K2	,,	0	•	0	0
	,,	ゾル液I2	n	0	•	0	0
	,,	ゾル液P2	n	0	0	0	0
	,,	ゾル液N2	•	0	•	0	0
	~	ゾル液T2	r,	0	•	0	0
比較例2	n	ソル液H2	r	0	0	×	×

基板処理した感光性平版印刷版は、ベタ耐刷性、ハイライト耐刷性に何ら性能劣化をおこすことなく、非画像部の地汚れのおこりにくさ、ブランケット汚れのおこりにくさの点で、比較用の平版印刷版の性能を凌いでいる。

85

* D基板を実施例1と同様に処理し、この基板上に下記組成の高感度光重合性組成物2~4を乾燥塗布重量が1.4g/m²となるように塗布し、80℃で2分間乾燥させ、感光層を形成した。
【0181】

【0180】実施例3

実施例2記載のゾル液A2、K2およびI2を用いてA*

光重合性組成物 2

トリメチロールプロパントリ (アクリロイルオキシプロピル)

エーテル 2.0g 線状有機高分子重合体 (B_1) 2.0g 増感剤 (C_2) 0.13g $(\lambda_{\text{max}} \quad 474 \text{nm} \, (\varepsilon=7.4\times10^4))$ 2.0g つ、2.0g つ、3 g フッ素系ノニオン界面活性剤 2.0g つ、0.3g

メチルエチルケトン 20g プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート 20g

20

*

[0182] [化56] (C₂) ※【0183】(注)線状有機高分子重合体(B₁)及び 光重合開始剤(D₁)は前記通りである。

[0184]

光重合性組成物3

ペンタエリスリトールトリアクリレート 2. 0 g 線状有機高分子重合体(B₁) 2. 0 g 增感剤(C2) 0.13g 光開始剤 (D2) 0. 1 g チオ化合物 (E₂) 0.07g フッ素系ノニオン界面活性剤 0.03g メチルエチルケトン 20 g プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート 20g

40

【0185】 【化57】 (D₂) ★【0186】(注)線状有機高分子重合体(B₁)及び 増感剤(C₂)は上記と同じものである。

[0187]

$$F_3C$$
 N CCl_3 N CCl_3

(E₂)

光重合性組成物 4

ペンタエリスリトールトリアクリレート 線状有機高分子重合体(B₁) 2. 0 g

2. 0 g

増感剤(C₂) 光開始剤(D₃)

添加剤(I)

フッ素系ノニオン界面活性剤

メチルエチルケトン

プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート

88 0.13g

0. 1 g

0.2g

0.03g

20g

20g *【0189】(注)線状有機高分子重合体(B₁)及び

増感剤(C2)は上記と同じものである。

[0188] 【化58】 (D₃)

(I)

CH₃S

CC13 (C₂H₅OCCH₂)₂N

ĊНз

【0190】この感光層上にポリビニルアルコール(ケ

10 ン化度86.5~89モル%、重合度1000)の3重 量%の水溶液を乾燥塗布重量が2g/m²となるように塗 布し、100℃で2分間乾燥させ、本発明に従う感光性 平版印刷版を得た。また、比較例2で用いたゾル液H2 でAD基板を同様に処理し、さらに光重合性組成物2~ 4 およびポリビニルアルコールを同様に塗布して、比較 用の感光性平版印刷版を得た。実施例1と同様の性能評

価を行なった結果を下表5に示す。 [0191]

【表5】

ブラン ハイライト 非画像部 ベタ ケット 基板 ゾル液 感光性組成物 耐砌性 耐刷性 の地汚れ の汚れ 実施例3 ゾル液A2 光重合性組成物 2 0 0 0 0 AD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 O O ゾル液K2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 \circ 4 0 0 0 0 ブル液I2 2 # 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 比較例3 ゾル液H2 2 × × 3 0 0 × × 0 0 ×

【0192】本発明に従い分子量1000以下のフェノ ール類または有機リン酸系化合物を混ぜこんだゾル液で 基板処理した感光性平版印刷版は、ベタ耐刷性、ハイラ イト耐刷性に何ら性能劣化をおこすことなく、非画像部 の地汚れのおこりにくさ、ブランケット汚れのおこりに※ ※くさの点で、比較用の平版印刷版の性能を凌いでいる。 【0193】実施例4

実施例1と同様にして、以下の原材料を混合することに よりゾル液A4およびL4を調製した。

ゾル液A4

水

フェニルホスホン酸 0.24重量部 メタノール 130重量部 20重量部 水 16重量部 85%リン酸 50重量部 Si(OC2 H5)4 3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン 30重量部 ゾル液L4 フェニルホスホン酸 0.24重量部 メタノール 130重量部

20重量部

85%リン酸 Si (OC2 H5)4

アリルトリエトキシシラン

【0194】次に、AD基板をこれらのゾル液で実施例 1と同様に処理し、光重合性組成物 4 およびポリビニル アルコールを実施例1と同様に塗布して感光性平版印刷 版を得た。また、有機リン酸系化合物を添加しないこと 以外はゾル液A4と全く同様にしてゾル液H3を調製 し、さらに有機リン酸系化合物を添加しないこと以外は

90 16重量部

50重量部 25重量部

様の性能評価を行なった結果を下表6に示す。

*ル液H3、H4でAD基板を同様に処理し、さらに光重 合性組成物 4 およびポリビニルアルコールを同様に塗布 して、比較用の感光性平版印刷版を得た。実施例1と同

[0195]

【表6】

ゾル液 L 4 と全く同様にしてゾル液 H 4 を調製した。ゾ*10

	基板	ゾル	⁄ 液	感光性組成物	ベタ 耐刷性	ハイライト 耐刷性	非画像部 の地汚れ	ブラン クット の汚れ
実施例4	AD	プル i	夜 A4	光重合性組成物4	0	0	0	0
#	~	ø	L4	я	0	0	0	0
比較例4		P	нз	tt	0	0	×	×
,,	*	^	H4	*	0	•	×	×

【0196】本発明に従って、有機リン酸系化合物を混 ぜこんだゾル液で基板処理した感光性平版印刷版は、ベ 20 タ耐刷性、ハイライト耐刷性に何ら性能劣化をおこすこ となく、非画像部の地汚れのおこりにくさ、ブランケッ ト汚れのおこりにくさの点で、比較用の平版印刷版の性※

※能を凌いでいる。

【0197】実施例5

実施例1と同様にして、以下の原材料を混合することに よりゾル液A5を調製した。

ゾル液A5

フェニルホスホン酸 メタノール

水 硫酸

Si (OC2 H5)4 3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン 0.24重量部

130重量部

3 4 重量部

12重量部

50重量部 30重量部

★乾燥させて感光層を形成し、感光性平版印刷版を得た。

次に、AD基板をこのゾル液で実施例1と同様に処理 し、その上に下記組成の光架橋性組成物1を乾燥塗布重 量が1.5g/m となるように塗布し、80℃で2分間★

[0198]

光架橋性組成物1

N [2-(メタクリロイルオキシ) エチル] -2. 3-ジメチルマレイミド/メタクリル酸

=65/35(重量比)共重合体

5重量部

0.25重量部

下記構造式で表わされる増感剤

☆【0200】

40

[0199]

プロピレングリコールモノメチルエーテル

80重量部 80重量部

メチルエチルケトン

メガファックF-177(大日本インキ(株)製、

フッ素系ノニオン界面活性剤)

0.03重量部

銅フタロシアニン顔料 (CL Pigment Blue 15)

の可塑剤10%分散液

1 重量部

【0201】また、有機リン酸系化合物を添加しないこ と以外はゾル液A5と全く同様にしてゾル液H5を調製 し、これを用いてAD基板を同様に処理し、さらに光架 橋性組成物 1 を同様に塗布して、比較用の感光性平版印 刷版を得た。これらの感光性平版印刷版を富士写真フイ ルム (株) 製PSライトにて1mの距離から1分間ネガ フィルムを用いて画像露光し、富士写真フィルム(株) 社製水性アルカリ現像液 DP-4を水道水で容積比1:* *7に希釈した液、同社製ガム液FPを水道水で容積比 1:1に希釈した液を用いて、同社製自動現像機PS-800Hにて現像処理した後、ハイデルベルグGTO印 刷機において印刷テストを行なった。結果を表7に示 す。

92

[0202] 【表7】

	基板	ゾル液	感光性組成物	ベタ 耐刷性	ハイライト 耐刷性	非画像部 の地汚れ	ブラン ケット の汚れ
実施例5	AD	ゾル液A5	光架橋性組成物1	0	0	0	0
比較例5	**	a H5	"	0	0	×	×

【0203】本発明に従い有機リン酸系化合物を混ぜこ んだゾル液で基板処理した感光性平版印刷版は、ベタ耐 刷性、ハイライト耐刷性に何ら性能劣化をおこすことな く、非画像部の地汚れのおこりにくさ、ブランケット汚 れのおこりにくさの点で、比較用の平版印刷版の性能を※

※凌いでいる。

【0204】実施例6

実施例1と同様にして、以下の原材料を混合することに よりゾル液A6を調製した。

ゾル液A6

フェニルホスホン酸 0.24重量部 メタノール 130重量部 20重量部 7K 85%リン酸 16重量部 50重量部 Si (OC2 H5)4 3-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン 30重量部

次に、SI基板をこのゾル液で実施例1と同様に処理 し、その上に下記組成のネガ組成物1を乾燥塗布重量 が、1.5g/m²となるように塗布し、80℃で2分間★

★乾燥させて感光層を形成し、感光性平版印刷版を得た。 [0205]

ネガ組成物1

4 - ジアゾジフェニルアミンとホルムアルデヒドの

縮合物の六フッ化リン酸塩	1. 0重量部
ポリマー (a)	5.0重量部
リンゴ酸	0.05重量部
FC-430(米国3M社製フッ素系界面活性剤)	0.05重量部
油溶性染料(ビクトリアピュアーブルーBOH)	0.1重量部
2ーメトキシエタノール	60重量部
メタノール	20重量部
メチルエチルケトン	20重量部

29の実施例3に記載されているビニル共重合体であ る。また、有機リン酸系化合物を添加しないこと以外は ゾル液A6と全く同様にしてゾル液H6を調製し、これ を用いて S I 基板を同様に処理し、さらにネガ組成物 1 を同様に塗布して、比較用の感光性平版印刷版を得た。 これらの感光性平版印刷版を富士写真フイルム(株)製 PSライトにて1mの距離から1分間ネガフィルムを用

【0206】注) ポリマー (a) は特公昭55-349 40 いて画像露光し、同社製水性アルカリ現像液DN-3C を水道水で容積比1:1に希釈した液および同社製ガム 液 F N - 2を水道水で容積比1:1に希釈した液を用い て、同社製自動現像機PS-800Hにて現像処理した 後、ハイデルベルグGTO印刷機において印刷テストを 行なった。結果を表8に示す。

[0207]

【表8】

9	3						94
	基板	ゾル液	感光性組成物	ベタ 耐刷性	ハイライト 耐刷性	非画像部の地汚れ	ブラン ケット の汚れ
実施例6	SI	ゾル液A6	ネガ組成物1	0	0	0	0
比較例6		• H6	<i>n</i>	0	0	×	×

【0208】本発明に従い有機リン酸系化合物を混ぜこ んだゾル液で基板処理した感光性平版印刷版は、ベタ耐 刷性、ハイライト耐刷性に何ら性能劣化をおこすことな れのおこりにくさの点で、比較用の平版印刷版の性能を 凌いでいる。

*【0209】実施例7

実施例6記載のゾル液A6でAD基板を実施例1と同様 に処理し、その上に下記組成のポジ組成物 1 を乾燥塗布 く、非画像部の地汚れのおこりにくさ、ブランケット汚 10 重量が1. $5 g / m^2$ となるように塗布し、8 0 % 0 %間乾燥させて感光層を形成し、感光性平版印刷版を得

ポジ組成物1

1. 2-ジアゾナフトキノン-5-スルホニルクロリドと ピロガロールーアセトン樹脂とのエステル化物(米国特 許第3,635,709号明細書の実施例に記載されて いるもの)

クレゾールホルムアルデヒドノボラック樹脂

45重量部 110重量部

2-(p-メトキシフェニル)-4,6-ビス(トリクロ

ロメチル) - s - トリアジン

2重量部

オイルブルー#603(オリエント化学工業(株)製) メガファックF-177 (大日本インキ化学工業 (株) 製 1重量部

フッ素系界面活性剤)

0. 4 重量部

メチルエチルケトン

100重量部

プロピレングリコールモノチルエーテル

100重量部

【0210】また、有機リン酸系化合物を添加しないこ と以外はゾル液A6と全く同様にして調製された実施例 6記載のゾル液H6を用いてAD基板を同様に処理し、 さらにポジ組成物1を同様に塗布して、比較用の感光性 平版印刷版を得た。これらの感光性平版印刷版を富士写 30 す。 真フイルム(株)製PSライトにて1mの距離から1分 間ネガフィルムを用いて画像露光し、富士写真フイルム

※ 1:1に希釈した液、同社製ガム液 FPを水道水で容積 比1:1に希釈した液を用いて、同社製自動現像機PS -800Hにて現像処理した後、ハイデルベルグGTO 印刷機において印刷テストを行なった。結果を表9に示

[0211] 【表9】

(株)製水性アルカリ現像液 DP-4を水道水で容積比※

	基板	ゾル液	感光性組成物	ベタ 耐刷性	ハイライト 耐刷性	非画像部 の地汚れ	ブラン ケット の汚れ
実施例?	AD	ゾル液A6	ポジ組成物1	0	0	0	0
比較例7		" H6	~	0	0	×	×

【0212】本発明に従い有機リン酸系化合物を混ぜこ 40 んだゾル液で基板処理した感光性平版印刷版は、ベタ耐 刷性、ハイライト耐刷性に何ら性能劣化をおこすことな く、非画像部の地汚れのおこりにくさ、ブランケット汚 れのおこりにくさの点で、比較用の平版印刷版の性能を 凌いでいる。

[0213]

【発明の効果】本発明により、従来、密着性と親水性の コントロールが難しかったゾルゲル処理液に重合性官能 基をより多く組み込むことが可能となり光接着を効率よ く進行させることができると共に、非画像部の親水性が 損なわれず汚れを防止することができる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁶ G O 3 F 7/11

識別記号 庁内整理番号

F I G O 3 F 7/11 技術表示箇所

•

.